# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-274730

(43)Date of publication of application: 21.10.1997

(51)Int.CI.

G11B 7/135 G11B 7/125

(21)Application number: 08-250081

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

20.09.1996

(72)Inventor: KATAYAMA RYUICHI

(30)Priority

Priority number: 08 19744

Priority date: 06.02.1996

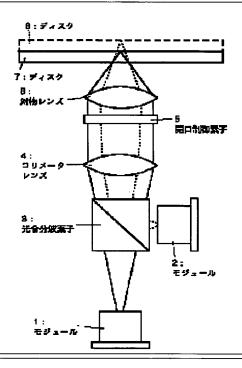
Priority country : JP

## (54) OPTICAL HEAD DEVICE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable the recording and reproducing in two kinds of optical recording mediums having substrates of different thicknesses.

SOLUTION: An outgoing light having a wavelength of 635nm from a semiconductor laser in the inside of a module 1 is converged on a disk 7 having a 0.6mm thick substrate such as a digital video disk. Reflected light from the disk 7 is received with a photodetector in the inside of the module 1. The outgoing light having a wavelength of 785nm from the semiconductor laser in the inside of the module 2 is converged on a disk 8 having a 1.2mm thick substrate such as a compact disk. Relected light from the disk 8 is received with a photodetector in the inside of the module 2. The length of the optical path with respect to a light having a wavelength of 785nm from the module 2 to a collimating lens 4 is shorter than the length of the optical path with respect to a light having a wavelength of 635nm from the module 1 to a collimating lens 4.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 20.09.1996 [Date of sending the examiner's decision of rejection] 01.09.1998

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3062099
[Date of registration] 28.04.2000
[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 10-15220
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 25.09.1998

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-274730

(43)公開日 平成9年(1997)10月21日

 (51) Int.Cl.6
 機別配号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 G 1 1 B
 7/135
 G 1 1 B
 7/135
 Z

 7/125
 7/125
 A

審査請求 有 請求項の数36 OL (全 41 頁)

(21)出願番号 特願平8-250081

(22)出願日 平成8年(1996)9月20日

(31) 優先権主張番号 特顧平8-19744 (32) 優先日 平8 (1996) 2月6日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 片山 龍一

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

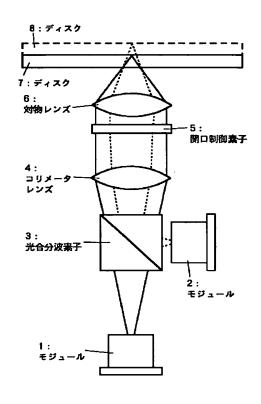
(74)代理人 弁理士 松浦 兼行

## (54) 【発明の名称】 光ヘッド装置

#### (57) 【要約】

【課題】 基板厚さの異なる二種類の光記録媒体の再生時に、光の利用効率が低下するために再生信号のS/Nが低下する。 波長635nm~650nmの光を出射する半導体レーザを用いるときは、追記型コンパクトディスクの再生ができない。

【解決手段】 モジュール1内の半導体レーザからの波長635nmの出射光は、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、モジュール1内の光検出器で受光される。モジュール2内の半導体レーザからの波長785nmの出射光は、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、モジュール2内の光検出器で受光される。モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長は、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長よりも短い。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第一の波長の光を出射する第一の光源と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、第一及び第二の光検出器と、前記第一の光源からの出射光と前記第二の光源からの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録媒体に導くと共に、前記第一の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光を前記第一の光検出器に導き、前記第二の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光を前記第二の光検出器に導く光合分波手段と、該光合分波手段と前記光記録媒体の間に設けられた、対物レンズを含むレンズ系を有する光ヘッド装置であって、

前記第二の基板厚さは前記第一の基板厚さよりも厚く、かつ、前記第二の光源から前記レンズ系までの実効的な 光路長は、前記第一の光源から前記レンズ系までの実効 的な光路長よりも短く設定されており、前記第一の光源 からの出射光を用いて前記第一の基板厚さの光記録媒体 に対し記録あるいは再生を行い、前記第二の光源からの 出射光を用いて前記第二の基板厚さの光記録媒体に対し 記録あるいは再生を行うことを特徴とする光へッド装 置。

【請求項2】 第一の波長の光を出射する第一の光源と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、光検出器と、前記第一の光源からの出射光と前記第二の光源からの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録媒体に導くと共に、前記第一の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光、及び前記第二の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光を前記光検出器に導く光合分波手段と、該光合分波手段と前記光記録媒体の間に設けられた、対物レンズを含むレンズ系を有する光へッド装置であって、

前記第二の基板厚さは前記第一の基板厚さよりも厚く、かつ、前記第二の光源から前記レンズ系までの実効的な 光路長は、前記第一の光源から前記レンズ系までの実効 的な光路長よりも短く設定されており、前記第一の光源 からの出射光を用いて前記第一の基板厚さの光記録媒体 に対し記録あるいは再生を行い、前記第二の光源からの 出射光を用いて前記第二の基板厚さの光記録媒体に対し 記録あるいは再生を行うことを特徴とする光へッド装 置。

【請求項3】 第一の波長の光を出射する第一の光源 と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、光検出器 と、前記第一の光源からの出射光と前記第二の光源からの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録媒体に導くと共に、前記第一の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光、及び前記第二の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光を前記光検出器に導く光合分波手段と、該光合分波手段と前記光記録媒体の間に設けられた対物レンズと、前記第一の光源と前記光合分波手段の間に設けられた第一のコリメータレンズと、

前記第二の光源と前記光合分波手段の間に設けられた第二のコリメータレンズを有する光へッド装置であって、前記第二の基板厚さは前記第一の基板厚さよりも厚く、かつ、前記第二の光源から前記第二のコリメータレンズのまでの実効的な光路長と前記第二のコリメータレンズの焦点距離との差は、前記第一の光源から前記第一のコリメータレンズまでの実効的な光路長と前記第一のコリメータレンズ。焦点距離との差よりも小さく設定されており、前記第一の光源からの出射光を用いて前記第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行い、前記第二の光源からの出射光を用いて前記第二の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うことを特徴とする光へッド装置。

【請求項4】 第一の波長の光を出射する第一の光源と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、第一及び第二の光検出器と、前記第一の光源からの出射光と前記第二の光源からの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録媒体に導くと共に、前記第一の光源から出射して前記光記録媒体で反射された光を前記第一の光検出器に導き、前記第二の光検出器に導く光合分波手段と、該光合分波手段と前記光記録媒体の間に設けられた対物レンズと、前記第一の光源と前記光合分波手段の間に設けられた第一のコリメータレンズと、前記第二の光源と前記光合分波手段の間に設けられた第一のコリメータレンズと、前記第二の光源と前記光合分波手段の間に設けられた第二のコリメータレンズを有する光へッド装置であって、

前記第一又は第二のコリメータレンズと前記光合分波手段との間に、前記第二の光源からの出射光を前記対物レンズに発散光として、又は前記第一の光源からの出射光を前記対物レンズに収束光として入射させるためのレンズ手段が設けられており、前記第一の光源からの出射光を用いて前記第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行い、前記第二の光源からの出射光を用いて前記第一の基板厚さよりも厚い前記第二の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うことを特徴とする光へッド装置。

【請求項5】 前記第一の波長は635nmの近傍で、前記第二の波長は785nmの近傍であることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の光ヘッド装置。

【請求項6】 前記光合分波手段と前記対物レンズの間に設けられた、前記第一の波長に対しては入射光をすべて透過させ、前記第二の波長に対しては入射光の断面の中心部分のみを透過させる開口制御素子を有することを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の光ヘッド装置。

【請求項7】 前記開口制御素子及び前記対物レンズは、アクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動されることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項8】 前記開口制御素子は、基板上の前記対物

レンズの有効径よりも小さい直径の円形領域の外側に誘電体多層膜が形成され、前記円形領域の内側に位相補償膜が形成された構成であり、前記誘電体多層膜は前記第一の波長の光をすべて透過させ、かつ、前記第二の波長の光をすべて反射させ、前記位相補償膜は前記第一の波長に対し、前記円形領域の外側を通る光と前記円形領域の内側を通る光の位相差を0又はその近傍に調整することを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項9】 前記開口制御素子は、前記対物レンズの有効径よりも小さい直径の円形領域の外側に回折格子層及び誘電体多層膜が形成された基板と、前記円形領域の内側に位相補償膜が形成された基板を、接着剤を介して貼り合わせた構成であり、前記誘電体多層膜は前記第一の波長の光をすべて透過させ、かつ、前記第二の波長の光をすべて反射させ、前記位相補償膜は前記第一の波長に対し、前記円形領域の外側を通る光の位相差を0又はその近傍に調整することを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項10】 前記レンズ系はコリメータレンズ及び 対物レンズからなることを特徴とする請求項1又は2記 載の光ヘッド装置。

【請求項11】 前記レンズ系は対物レンズのみからなることを特徴とする請求項1又は2記載の光ヘッド装置。

【請求項12】 前記第一の光源と前記第一の光検出器は、第一の共通のパッケージに収納されており、前記第二の光源と前記第二の光検出器は、第二の共通のパッケージに収納されていることを特徴とする請求項1又は4記載の光ヘッド装置。

【請求項13】 前記第一又は第二の光源のいずれか一方と前記光検出器は、共通のパッケージに収納されていることを特徴とする請求項2又は3記載の光ヘッド装置。

【請求項14】 前記光合分波手段は、前記第一又は第二の波長のいずれか一方に対しては入射光を透過させ、他方に対しては入射光を反射させる誘電体多層膜を有する素子であることを特徴とする請求項1又は4記載の光ヘッド装置。

【請求項15】 前記光合分波手段は、前記第一の波長に対しては入射光を反射させ、前記第二の波長に対しては入射光を透過させる誘電体多層膜を有し、かつ、前記第一の波長に対し、前記光源からの出射光を、少なくとも1回反射させて前記誘電体多層膜に入射させる反射面を有する素子であることを特徴とする請求項1記載の光へッド装置。

【請求項16】 前記光合分波手段は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては入射光を+1次回折光として反射回折させるホログラムを有する素子であり、前記ホログラムは、+1次回折光に対して凸面ミラーとしての働きをすることを特徴と

する請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項17】 前記ホログラムは、斜面にホログラム 層及び誘電体多層膜が形成された第一のプリズムと、第 二のプリズムを接着剤を介して貼り合わせた構成であ り、前記誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては入射光を反射させることを特徴とする請求項16記載の光ヘッド装置。

【請求項18】 前記光合分波手段は、前記第一の波長に対しては入射光を+1次回折光として反射回折させ、前記第二の波長に対しては入射光を透過させるホログラムを有する素子であり、前記ホログラムは、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをすることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項19】 前記ホログラムは、斜面にホログラム 層及び誘電体多層膜が形成された第一のプリズムと、第 二のプリズムを接着剤を介して貼り合わせた構成であ り、前記誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入 射光を反射させ、前記第二の波長に対しては入射光を透 過させることを特徴とする請求項18記載の光ヘッド装 置。

【請求項20】 前記レンズ系と前記光検出器の間に設けられた、前記レンズ系から前記光検出器までの前記第二の波長に対する実効的な光路長を、前記レンズ系から前記光検出器までの前記第一の波長に対する実効的な光路長よりも短くするための光路制御手段を有することを特徴とする請求項2記載の光ヘッド装置。

【請求項21】 前記光合分波手段及び前記光路制御手段は、前記第一の波長に対し、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させる第一の誘電体多層膜と、前記第一の波長に対しては入射光を反射させる第二の誘電体多層膜を有し、かつ、前記第一の波長に対し、前記光記録媒体からの反射光を、前記第二の誘電体多層膜を透過し、前記第一の誘電体多層膜で反射された後に、少なくとも1回反射させて再び前記第二の誘電体多層膜に入射させる反射面を有する同一の素子であることを特徴とする請求項20記載の光ヘッド装置。

【請求項22】 前記光合分波手段及び前記光路制御手段は、前記第一の波長に対しては入射光を反射させ、前記第二の波長に対しては入射光を透過させる第一の誘電体多層膜と、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させる第二の誘電体多層膜を有し、かつ、前記第一の波長に対し、前記光記録媒体からの反射光を、前記第二の誘電体多層膜を透過し、前記第一の誘電体多層膜で反射された後に、少なくとも1回反射させて再び前記第二の誘電体多層膜に入射させる反射面を有する同一の素子であることを特徴とする請求項20記載の光へッド装置。

【請求項23】 前記光合分波手段及び前記光路制御手段は、前記第一の波長に対しては、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を+1次回折光として反射回折させ、前記第二の波長に対しては入射光を反射させるホログラムを有する同一の素子であり、前記ホログラムは、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをすることを特徴とする請求項20記載の光ヘッド装置。

【請求項24】 前記ホログラムは、斜面にホログラム層及び第一の誘電体多層膜が形成された第一のプリズムと、斜面に第二の誘電体多層膜が形成された第二のプリズムを接着剤を介して貼り合わせた構成であり、前記第一の誘電体多層膜は、前記第一の波長に対し、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させ、前記第二の誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては入射光を反射させることを特徴とする請求項23記載の光ヘッド装置。

【請求項25】 前記光合分波手段及び前記光路制御手段は、前記第一の波長に対しては入射光を+1次回折光として反射回折させ、前記第二の波長に対しては、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させるホログラムを有する同一の素子であり、前記ホログラムは、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをすることを特徴とする請求項20記載の光ヘッド装置。

【請求項26】 前記ホログラムは、斜面にホログラム層及び第一の誘電体多層膜が形成された第一のプリズムと、斜面に第二の誘電体多層膜が形成された第二のプリズムを接着剤を介して貼り合わせた構成であり、前記第一の誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させることを特徴とする請求項25記載の光ヘッド装置。

【請求項27】 前記光合分波手段は、前記第一又は第二の波長のいずれか一方に対しては、前記光源からの出射光を透過させ、前記光記録媒体からの反射光を反射させ、他方に対しては、入射光を反射させる誘電体多層膜を有する素子であることを特徴とする請求項3記載の光へッド装置。

【請求項28】 前記光合分波手段は、前記第一又は第二の波長のいずれか一方に対しては、前記光源からの出射光を反射させ、前記光記録媒体からの反射光を透過させ、他方に対しては、入射光を透過させる誘電体多層膜を有する素子であることを特徴とする請求項3記載の光ヘッド装置。

【請求項29】 前記第一又は第二のコリメータレンズ

と前記光検出器の間に設けられた、前記第一又は第二のコリメータレンズから前記光検出器までの前記第二の波長に対する実効的な光路長を、前記第一又は第二のコリメータレンズから前記光検出器までの前記第一の波長に対する実効的な光路長よりも短くするための光路制御手段を有することを特徴とする請求項3記載の光ヘッド装置。

【請求項30】 前記光路制御手段は、前記第一の波長に対しては入射光を透過させ、前記第二の波長に対しては入射光を反射させる誘電体多層膜を有し、かつ、前記第一の波長に対し、前記光記録媒体からの反射光を、前記誘電体多層膜を透過した後に、少なくとも2回反射させて再び前記誘電体多層膜に入射させる反射面を有する素子であることを特徴とする請求項29記載の光ヘッド装置。

【請求項31】 前記光路制御手段は、前記第一の波長に対しては入射光を+1次回折光として反射回折させ、前記第二の波長に対しては入射光を反射させるホログラムを有する素子であり、前記ホログラムは、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをすることを特徴とする請求項29記載の光ヘッド装置。

【請求項32】 前記ホログラムは、プリズムの斜面に 誘電体多層膜及びホログラム層が形成された構成であ り、前記誘電体多層膜は、前記第一の波長に対しては入 射光を透過させ、前記第二の波長に対しては入射光を反 射させることを特徴とする請求項31記載の光ヘッド装 置。

【請求項33】 前記ホログラム層の断面は階段状であることを特徴とする請求項17、19、24、26又は32記載の光ヘッド装置。

【請求項34】 前記第一及び第二の光源のうちいずれか一方から出射された光は前記レンズ系の対物レンズに平行光として入射し、他方の光は発散光又は収束光として入射し、前記対物レンズは該平行光として入射する光が、該光により記録あるいは再生されるべき光記録媒体の基板厚さの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有することを特徴とする請求項1又は2記載の光ヘッド装置。

【請求項35】 前記レンズ手段は、前記第二のコリメータレンズと前記光合分波素子との間に設けられた、前記第二の光源からの出射光を前記対物レンズに発散光として入射させる凹レンズ又は凸レンズであることを特徴とする請求項4記載の光ヘッド装置。

【請求項36】 前記レンズ手段は、前記第一のコリメータレンズと前記光合分波素子との間に設けられた、前記第一の光源からの出射光を前記対物レンズに収束光として入射させる凸レンズであることを特徴とする請求項4記載の光ヘッド装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うための光ヘッド装置に係り、特に基板厚さの異なる二種類の光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うための光ヘッド装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンパクトディスクに比べて大容量のディジタルビデオディスク等の光ディスクの規格化が進められている。ディジタルビデオディスク等の規格では、基板厚さ0.6mmのディスクを用いる。これに対し、従来のコンパクトディスク等の規格では、基板厚さ1.2mmのディスクを用いる。そこで、ディジタルビデオディスクとコンパクトディスクの両方を再生できる光ヘッド装置が望まれている。

【0003】しかし、通常の光ヘッド装置においては、対物レンズが予め定めた基板厚さのディスクに対して球面収差を打ち消すように設計されているため、別の基板厚さのディスクに対しては球面収差が残留し、正しく再生することができない。そこで、従来より基板厚さの異なるディジタルビデオディスクとコンパクトディスクの両方を再生できる光ヘッド装置が種々提案されている(例えば、特開平7-65407号公報など)。

【0004】図50は従来の光へッド装置の一例の構成図を示す。同図において、半導体レーザ237からの出射光は、ハーフミラー238で約半分が反射され、開口239を透過し、光路制御素子240に入射して第一の光と第二の光に分けられる。光路制御素子240を出射した第一の光は、コリメータレンズ4を透過し、対物レンズ6に平行光として入射し、第1の光ディスクであるディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。一方、光路制御素子240を出射した第二の光は、コリメータレンズ4を透過し、対物レンズ6に発散光として入射し、第2の光ディスクであるコンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。

【0005】ディスク7で反射された第一の光、及びディスク8で反射された第二の光は、対物レンズ6、コリメータレンズ4、光路制御素子240、開口239を逆向きに通り、ハーフミラー238を約半分が透過し、更に凹レンズ241を透過して光検出器242で受光される。

【0006】図51は光路制御素子240の一例の構成図を示す。光路制御素子240は、プリズム243及びプリズム244を、偏光分離膜245を介して貼り合わせた構成である。偏光分離膜245は、入射光のうちP偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。光路制御素子240への入射光のうち、偏光分離膜245に対するP偏光成分である入射光248は、図51(a)に示すように、偏光分離膜245をすべて透過し、プリズム244の反射膜246及び反射膜247で反射され、再び偏光分離膜245をすべ

て透過し、プリズム243を出射して第一の光となる。 一方、光路制御素子240への入射光のうち、偏光分離膜245に対するS偏光成分である入射光249は、図51(b)に示すように、偏光分離膜245ですべて反射され、プリズム243を出射して第二の光となる。

【0007】従って、図50に示す従来の光ヘッド装置 の構成では、光路制御素子240による第一の光に対す る実効的な光路長と、第二の光に対する実効的な光路長 とが異なるため、半導体レーザ237からコリメータレ ンズ4までの第二の光に対する実効的な光路長は、半導 体レーザ237からコリメータレンズ4までの第一の光 に対する実効的な光路長よりも短い。従って、半導体レ ーザ237からコリメータレンズ4までの実効的な光路 長を、第一の光が対物レンズ6に平行光として入射する ように調整すると、第二の光は対物レンズ6に発散光と して入射する。対物レンズ6は、対物レンズ6に平行光 として入射した光が厚さ0.6mmの基板を透過する際 に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。このと き、対物レンズ6に平行光として入射した光が厚さ1. 2mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。し かし、対物レンズ6に発散光として光を入射させると、 対物レンズ6の像点移動に伴う新たな球面収差が生じ、 これが1.2mmの基板を透過する際に残留する球面収 差を打ち消す方向に働く。従って、半導体レーザ237 からコリメータレンズ4までの第一の光と第二の光に対 する実効的な光路長の差を最適に設定することにより、 第一の光は基板厚さ0.6mmのディスク7上に無収差 で集光され、第二の光は基板厚さ1.2mmのディスク 8上に無収差で集光される。

【0008】コンパクトディスク等の規格における対物レンズの開口数は、ディジタルビデオディスク等の規格における対物レンズの開口数よりも小さい。図50に示す構成では、半導体レーザ237からコリメータレンズ4までの第一の光と第二の光に対する実効的な光路長が異なるため、光学系中に開口239を設けることにより、対物レンズ6に入射する第二の光のビーム径を、対物レンズ6に入射する第一の光のビーム径よりも小さくすることができる。従って、対物レンズ6の第二の光に対する実効的な開口数は、対物レンズ6の第一の光に対する実効的な開口数よりも小さくなり、上記の要請は満たされる。

【0009】図52は図50に示した従来の光ヘッド装置に用いる光路制御素子240の別の構成を示す。図52に示す光路制御素子240は、プリズム10の斜面にホログラム250が形成された構成である。光路制御素子240への入射光のうち、ホログラム250に対するP偏光成分である入射光248は、図52(a)に示すように、ホログラム250で+1次回折光として反射回折され、プリズム10を出射して第二の光となる。一方、光路制御素子240への入射光のうち、ホログラム

250に対するS偏光成分である入射光249は、図52(b)に示すように、ホログラム250ですべて反射され、プリズム10を出射して第一の光となる。

【0010】図53は図52に示したホログラム250 の一例の構成図を示す。ホログラム250は、プリズム 10の斜面に偏光分離膜251及びホログラム層248 が形成された構成である。偏光分離膜251は、入射光 のうちP偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべ て反射させる働きをする。ホログラム250は、+1次 回折光に対して凸面ミラーとしての働きをする。ホログ ラム250への入射光のうち、偏光分離膜251に対す るP偏光成分である入射光248は、偏光分離膜251 をすべて透過し、ホログラム層252で+1次回折光と して反射回折され、再び偏光分離膜251をすべて透過 し、ホログラム250を出射して第二の光となる。一 方、ホログラム250への入射光のうち、偏光分離膜2 51に対するS偏光成分である入射光249は、偏光分 離膜251ですべて反射され、ホログラム250を出射 して第一の光となる。図53に示すように、ホログラム 層252の断面を階段状にすることにより、+1次回折 光に対する回折効率が高くなる。

【0011】図52に示す構成の光路制御素子240を用いると、第二の光に対する見かけ上の発光点は、第一の光に対する見かけ上の発光点よりも光路制御素子240に近付く。従って、半導体レーザ237からコリメータレンズ4までの第二の光に対する実効的な光路長を、半導体レーザ237からコリメータレンズ4までの第一の光に対する実効的な光路長よりも短くすることができる。

## [0012]

【発明が解決しようとする課題】図50に示す構成の従来の光へッド装置における第一の課題は、光路制御素子240で入射光が第一の光と第二の光に分けられるため、各々の光に対する利用効率が半分に低下することである。半導体レーザ237の出力が通常の光へッド装置と同じであるとすると、光検出器242の受光量は通常の光へッド装置の半分となり、再生信号の信号対雑音比(S/N)が低下する。従って、光検出器242の受光量を通常の光へッド装置と同じにするためには、半導体レーザ237の出力を通常の光へッド装置の2倍に高める必要がある。ディスク7、8の再生だけでなく記録を行うためには、半導体レーザ237の出力をさらに高める必要があり、事実上不可能である。

【0013】図50に示す構成の従来の光ヘッド装置における第二の課題は、半導体レーザ237の出射光の波長に関するものである。ディジタルビデオディスク等の規格では、用いる光の波長は635nm~650nmであるのに対し、コンパクトディスク等の規格では、用いる光の波長は785nmである。ディジタルビデオディスクとコンパクトディスクの両方を再生するためには、

半導体レーザ237として集光スポット径をより小さくできる、波長635nm~650nmの光を出射する半 導体レーザを用いる必要がある。

【0014】一方、コンパクトディスクの一種として、記録媒体として有機色素を用いた追記型コンパクトディスクがある。追記型コンパクトディスクは、波長785 nmでは70%以上の高い反射率が得られるが、波長635nm~650nmでは10%程度の低い反射率しか得られない。このため、従来の光ヘッド装置では、追記型コンパクトディスクの再生は不可能である。

【0015】本発明は以上の点に鑑みなされたもので、 基板厚さの異なる二種類の光記録媒体を再生できる従来 の光ヘッド装置における上述の課題を解決し、再生信号 のS/Nは通常と同程度であり、半導体レーザの出力も 通常と同程度で済み、再生だけでなく記録を行うことも 可能な光ヘッド装置を提供することを目的とする。

【0016】本発明の他の目的は、基板厚さの異なる二種類の光記録媒体を再生できる従来の光ヘッド装置における上述の課題を解決し、追記型コンパクトディスクの再生も可能な光ヘッド装置を提供することにある。

## [0017]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達 成するため、第一の波長の光を出射する第一の光源と、 第二の波長の光を出射する第二の光源と、第一及び第二 の光検出器と、第一の光源からの出射光と第二の光源か らの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録 媒体に導くと共に、第一の光源から出射して光記録媒体 で反射された光を第一の光検出器に導き、第二の光源か ら出射して光記録媒体で反射された光を第二の光検出器 に導く光合分波手段と、光合分波手段と光記録媒体の間 に設けられた、対物レンズを含むレンズ系を有する光へ ッド装置であって、第二の基板厚さは第一の基板厚さよ りも厚く、かつ、第二の光源からレンズ系までの実効的 な光路長は、第一の光源からレンズ系までの実効的な光 路長よりも短く設定されており、第一の光源からの出射 光を用いて第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録ある いは再生を行い、第二の光源からの出射光を用いて第二 の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行う ことを特徴とする。

【0018】また、本発明は、第一の波長の光を出射する第一の光源と、第二の波長の光を出射する第二の光源と、光検出器と、第一の光源からの出射光と第二の光源からの出射光を合波して第一又は第二の基板厚さの光記録媒体に導くと共に、第一の光源から出射して光記録媒体で反射された光、及び第二の光源から出射して光記録媒体で反射された光を光検出器に導く光合分波手段と、光合分波手段と光記録媒体の間に設けられた、対物レンズを含むレンズ系を有する光へッド装置であって、第二の基板厚さは第一の基板厚さよりも厚く、かつ、第二の光源からレンズ系までの実効的な光路長は、第一の光源

からレンズ系までの実効的な光路長よりも短く設定されており、第一の光源からの出射光を用いて第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行い、第二の光源からの出射光を用いて第二の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うことを特徴とする。

【0019】更に、本発明は、上記の第一の光源と光合分波手段の間に設けられた第一のコリメータレンズと、第二の光源と光合分波手段の間に設けられた第二のコリメータレンズを有する光へッド装置であるときは、第二の光源から第二のコリメータレンズまでの実効的な光路長と第二のコリメータレンズの焦点距離との差は、第一の光源から第一のコリメータレンズ。までの実効的な光路長と第一のコリメータレンズの焦点距離との差よりも小さく設定されていることを特徴とする。

【0020】また、更に本発明は、上記の第一又は第二のコリメータレンズと光合分波手段との間に、第二の光源からの出射光を対物レンズに発散光として、又は第一の光源からの出射光を対物レンズに収束光として入射させるためのレンズ手段を設けたことを特徴とする。

【0021】本発明では、第二の基板厚さは第一の基板厚さよりも厚く、かつ、第二の光源からレンズ系までの実効的な光路長は、第一の光源からレンズ系までの実効的な光路長よりも短く設定されており、第一の光源からの出射光を用いて第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行い、第二の光源からの出射光を用いて第二の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行う。従って、従来の光へッド装置に比し各々の光に対する利用効率を向上できる。

【0022】また、本発明の光ヘッド装置は、第二の波長を785nmにすることにより、従来の光ヘッド装置では不可能であった追記型コンパクトディスクの再生も可能である。

[0023]

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して本発明の 実施の形態について説明する。

【0024】図1は本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態の構成図を示す。同図において、モジュール1及びモジュール2には、後述するように半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール1内の半導体レーザの出射光の波長は635nm、モジュール2内の半導体レーザの出射光の波長は785nmである。

【0025】モジュール1内の半導体レーザからの出射光は、光合分波素子3、コリメータレンズ4、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に平行光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、コリメータレンズ4、光合分波素子3を逆向きに通り、モジュール1内の光検出器で受光される。

【0026】一方、モジュール2内の半導体レーザからの出射光は、光合分波素子3で反射され、コリメータレンズ4、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に発散光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、コリメータレンズ4、光合分波素子3を逆向きに通り、モジュール2内の光検出器で受光される。開口制御素子5は、対物レンズ6と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0027】図2は図1の光合分波素子3の一例の構成図を示す。光合分波素子3は、プリズム9及びプリズム10を、誘電体多層膜11を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜11は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

【0028】これにより、図2(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分液素子3のプリズム9に入射した波長635nmの入射光12は、誘電体多層膜11をすべて透過して光合分波素子3のプリズム10を出射する。一方、図2(b)に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子3のプリズム10に入射した波長785nmの入射光13は、誘電体多層膜11ですべて反射されて光合分波素子3のプリズム10を出射する。

【0029】図1に示した第一の実施の形態の構成では、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長は、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長よりも短い。従って、モジュール1及びモジュール2からコリメータレンズ4までの光路長を、波長635nmの光が対物レンズ6に平行光として入射するように調整すると、波長785nmの光は対物レンズ6に発散光として入射する。

【0030】対物レンズ6は、対物レンズ6に平行光として入射した光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。このとき、対物レンズ6に平行光として入射した光が厚さ1.2mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。しかし、対物レンズ6に発散光として光を入射させると、対物レンズ6の像点移動に伴う新たな球面収差が生じ、これが1.2mmの基板を透過する際に残留する球面収差を打ち消す方向に働く。

【0031】従って、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長と、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長の差を最適に設定することにより、波長635nmの光は基板厚0.6mmのディスク7上に無収差で集光され、波長785nmの光は基板厚1.2mmのディスク8上に無収差で集光される。

【0032】図1に示した第一の実施の形態の光ヘッド 装置では、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜11を 有する光合分波素子3を用いている。これに対し、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光 をすべて透過させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。この場合、モジュール1と モジュール2の位置を入れ換えればよい。

【0033】図3は本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態の構成図を示す。同図中、図1と同一構成部分には同一符号を付してある。モジュール1及びモジュール2には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール1内の半導体レーザの波長は635nm、モジュール2内の半導体レーザの波長は785nmである。

【0034】モジュール1内の半導体レーザからの出射 光は、光合分波素子14で反射され、コリメータレンズ 4、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に収束光 として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ 0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7か らの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、コリ メータレンズ4、光合分波素子14を逆向きに通り、モ ジュール1内の光検出器で受光される。

【0035】一方、モジュール2内の半導体レーザからの出射光は、光合分波素子14、コリメータレンズ4、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に平行光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、コリメータレンズ4、光合分波素子14を逆向きに通り、モジュール2内の光検出器で受光される。開口制御素子5は、対物レンズ15と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0036】図4は図3に示した第二の実施の形態で用いる光合分波素子14の第一の例の構成図を示す。図4(a)、(b)に示すように、光合分波素子14は、プリズム9及びプリズム10を、誘電体多層膜16を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜16は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる働きをする。

【0037】これにより、図4(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム10に入射した波長635nmの入射光17は、誘電体多層膜16ですべて反射されて光合分波素子14のプリズム10を出射する。一方、図4(b)に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム9に入射した波長785nmの入射光18は、誘電体多層膜16をすべて透過して光合分波素子14のプリズム10を出射する。光合分波素子14を用いた図3に示す光ヘッド装置では、モジュ

ール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長は、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長よりも長い。従って、モジュール1及びモジュール2からコリメータレンズ4までの光路長を、波長785nmの光が対物レンズ15に平行光として入射するように調整すると、波長635nmの光は対物レンズ15に収束光として入射する。

【0038】対物レンズ15は、対物レンズ15に平行光として入射した光が厚さ1.2mmの基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有する。このとき、対物レンズ15に平行光として入射した光が厚さ0.6mmの基板を透過する際には球面収差が残留する。しかし、対物レンズ15に収束光として光を入射させると、対物レンズ15の像点移動に伴う新たな球面収差が生じ、これが0.6mmの基板を透過する際に残留する球面収差を打ち消す方向に働く。

【0039】従って、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長と、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長の差を最適に設定すれば、波長635nmの光は基板厚0.6mmのディスク7上に無収差で集光され、波長785nmの光は基板厚1.2mmのディスク8上に無収差で集光される。

【0040】図3に示す第二の実施の形態の光ヘッド装置では、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜16を有する光合分波素子14を用いている。これに対し、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。この場合、図3に示したモジュール1とモジュール2の位置を入れ換えればよい。

【0041】図5は図3に示した第二の実施の形態に用いる光合分波素子14の第二の例の構成図を示す。この光合分波素子14は、プリズム19及びプリズム20を、誘電体多層膜21を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜21は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる働きをする。

【0042】これにより、図5(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム20に入射した波長635nmの入射光17は、反射膜22で反射され、誘電体多層膜21ですべて反射されて光合分波素子14のプリズム20を出射する。一方、図5(b)に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム19に入射した波長785nmの入射光18は、誘電体多層膜21をすべて透過して光合分波素子14のプリズム20を透過して出射する。

【0043】図6は図3に示した第二の実施の形態に用

いる光合分波素子14の第三の例の構成図を示す。この 光合分波素子14は、プリズム23及びプリズム24 を、誘電体多層膜25を介して貼り合わせた構成であ る。誘電体多層膜25は、波長635nmの光をすべて 反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる働き をする。

【0044】これにより、図6(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム24に入射した波長635nmの入射光17は、プリズム24と空気の境界面で2回全反射され、誘電体多層膜25ですべて反射されて光合分波素子14のプリズム24を出射する。一方、図6(b)に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム23に入射した波長785nmの入射光18は、誘電体多層膜25をすべて透過し、更に光合分波素子14のプリズム24を透過して出射する。

【0045】図3に示す構成では、モジュール1から光合分波素子14までの距離は、モジュール2から光合分波素子14までの距離よりも長い。しかし、図5及び図6に示す構成の光合分波素子を図3に示した光合分波素子14として用いると、モジュール1から光合分波素子14までの距離とモジュール2から光合分波素子14までの距離が等しくても、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長よりも長くすることができる。

【0046】図1及び図3に示した第一及び第二の実施の形態の光ヘッド装置では、光合分波素子3及び光合分波素子14における往復の光利用率は、波長635nm、波長785nmのいずれに対しても100%である。従って、波長635nmに関しては、ディスク7の再生信号のS/Nは通常と同程度であり、モジュール1内の半導体レーザの出力も通常と同程度で済み、ディスク7の再生だけでなく記録を行うことも可能である。

【0047】また、波長785nmに関しては、ディスク8の再生信号のS/Nは通常と同程度であり、モジュール2内の半導体レーザの出力も通常と同程度で済み、ディスク8の再生だけでなく記録を行うことも可能である。また、モジュール2内の半導体レーザの波長は785nmであるため、ディスク8が追記型コンパクトディスクの場合にも再生が可能である。

【0048】図7は図1に示した第一の実施の形態に用いる光合分波素子3の別の例の構成図を示す。この光合分波素子3は、プリズム9及びプリズム10を、ホログラム26を介して貼り合わせた構成である。これにより、図7(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分波素子3のプリズム9に入射した波長635nmの入射光12は、ホログラム26をすべて透過し、更に光合分波素子3のプリズム10を透過

して出射する。一方、図7 (b) に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子3のプリズム10に入射した波長785 nmの入射光13は、ホログラム26で+1次回折光として反射回折されて光合分波素子3のプリズム10を出射する。

【0049】図8は図7中のホログラム26の各例の構成図を示す。ホログラム26は、図8(a)に示すように、プリズム9の斜面にホログラム層である $SiO_2$ 膜27及び誘電体多層膜28が形成され、プリズム10の斜面との間に接着剤29が充填された構成である。また、図8(b)に示すホログラム26は、プリズム9の斜面にホログラム層である $SiO_2$ 膜30及び誘電体多層膜31が形成され、プリズム10の斜面との間に接着剤32が充填された構成で、図8(a)とは $SiO_2$ 膜30と誘電多層膜31の断面形状が異なる。

【0050】誘電体多層膜 28 及び 31 は、波長 635 nmの光をすべて透過させ、波長 785 nmの光をすべて反射させる働きをする。接着剤 29 及び 32 と SiO 2 膜 27 及び 30 は屈折率がほぼ同じである。 SiO 2 膜 27 又は 30、誘電体多層膜 28 又は 31、及び接着剤 29 及び 32 を組み合わせることにより、波長 635 nmの光はすべて透過し、波長 785 nmの光はすべて反射回折される。ホログラム 26 は、+1 次回折光に対して凸面ミラーとしての働きをする。

【0051】これにより、図8(a)、(b)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射してホログラム26に入射した波長635nmの入射光12は、SiO2膜27又は30、誘電体多層膜28又は31、及び接着剤29又は32をすべて透過してホログラム26を出射する。一方、モジュール2内の半導体レーザを出射してホログラム26に入射した波長785nmの入射光13は、接着剤29又は32、及び誘電体多層膜28又は31で+1次回折光として反射回折されてホログラム26を出射する。

【0052】図8 (a) に示すように、 $SiO_2$ 膜27 の断面が矩形状の場合、+1 次回折光に対する回折効率は最大で40.5%である。これに対し、図8 (b) に示すように、 $SiO_2$ 膜30 の断面が階段状の場合は、+1 次回折光に対する回折効率が高くなる。4 レベルの階段状の場合は最大で81%、8 レベルの階段状の場合は最大で95%である。

【0053】図1に示した第一の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、モジュール2から光合分波素子3までの距離は、モジュール1から光合分波素子3までの距離よりも短い。しかし、図7に示す構成の光合分波素子を光合分波素子3として用いると、波長785nmの光に対する見かけ上の発光点は、波長635nmの光に対する見かけ上の発光点よりも光合分波素子3に近付く。従って、モジュール1から光合分波素子3までの距離とモジュール2から光合分波素子3までの距離が等しくて

も、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長よりも短くすることができる。

【0054】図7に示す構成の光合分波素子3における往復の光利用率は、波長635nmに対しては100%であり、波長785nmに対しては、 $SiO_2$ 膜30の断面が4レベルの階段状の場合は最大で66%、8レベルの階段状の場合は最大で90%である。従って、波長635nmに関しては、ディスク7の再生信号のS/Nは通常と同程度であり、モジュール1内の半導体レーザの出力も通常と同程度で済み、ディスク7の再生だけでなく記録を行うことも可能である。

【0055】一方、波長785nmに関しては、モジュール2内の半導体レーザの出力が通常の光ヘッド装置と同じであるとすると、モジュール2内の光検出器の受光量は通常の光ヘッド装置の66%~90%になるが、従来の光ヘッド装置に比べればディスク8の再生信号のS/Nの低下量は少ない。また、モジュール2内の光検出器の受光量が通常の光ヘッド装置と同じであるためには、モジュール2内の半導体レーザの出力を通常の光ヘッド装置の1.1倍~1.5倍に高める必要があるが、従来の光ヘッド装置に比べれば容易に実現可能である。

【0056】図9は図3に示した第二の実施の形態に用いる光合分波素子14の第四の例の構成図を示す。この光合分波素子14は、図9(a)、(b)に示すように、プリズム9及びプリズム10を、ホログラム33を介して貼り合わせた構成である。図9(a)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム10に入射した波長635nmの入射光17は、ホログラム33で+1次回折光として反射回折されて光合分波素子14のプリズム10を出射する。一方、図9(b)に示すように、モジュール2内の半導体レーザを出射して光合分波素子14のプリズム9に入射した波長785nmの入射光18は、ホログラム33をすべて透過し、更に光合分波素子14のプリズム10を透過して出射する。

【0057】図10は図9中のホログラム33の各例の構成図を示す。ホログラム33は、図10(a)に示すように、プリズム9の斜面にホログラム層であるSiO2膜34及び誘電体多層膜35が形成され、プリズム10の斜面との間に接着剤36が充填された構成である。また、図10(b)に示すホログラム33は、プリズム9の斜面にホログラム層であるSiO2膜37及び誘電体多層膜38が形成され、プリズム10の斜面との間に接着剤39が充填された構成で、図10(a)とはSiO2膜37と誘電多層膜38の断面形状が異なる。

【0058】誘電体多層膜35及び38は、波長635 nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべ て透過させる働きをする。接着剤36及び39とSiO 2膜34及び37は屈折率がほぼ同じである。 $SiO_2$ 膜34又は37、誘電体多層膜35又は38、及び接着剤36又は39を組み合わせることにより、波長635 nmの光はすべて反射回折され、波長785 nmの光はすべて透過する。ホログラム33は、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをする。

【0059】図10(a)、(b)に示すように、モジュール1内の半導体レーザを出射してホログラム33に入射した波長635nmの入射光17は、接着剤36又は39、及び誘電体多層膜35又は38で+1次回折光として反射回折されてホログラム33を出射する。一方、モジュール2内の半導体レーザを出射してホログラム33に入射した波長785nmの入射光18は、SiO2膜34又は37、誘電体多層膜35又は38、及び接着剤36又は39をすべて透過してホログラム33を出射する。

【0060】図10(a)に示すように、 $SiO_2$ 膜34の断面が矩形状の場合、+1次回折光に対する回折効率は最大で40.5%である。これに対し、図10

(b) に示すように、 $SiO_2$ 膜37の断面を階段状にすることにより、+1次回折光に対する回折効率が高くなる。4 レベルの階段状の場合は最大で81%、8 レベルの階段状の場合は最大で95%である。

【0061】図3に示した第二の実施の形態の光へッドの構成では、モジュール1から光合分波素子14までの距離は、モジュール2から光合分波素子14までの距離よりも長い。しかし、図9に示す構成の光合分波素子を光合分波素子14として用いると、波長635nmの光に対する見かけ上の発光点は、波長785nmの光に対する見かけ上の発光点よりも光合分波素子から遠ざかる。従って、モジュール1から光合分波素子までの距離とモジュール2から光合分波素子までの距離が等しくても、モジュール1からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、モジュール2からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長よりも長くすることができる。

【0062】図9に示す構成の光合分波素子14における往復の光利用率は、波長635nmに対しては、SiO2膜37の断面が4レベルの階段状の場合は最大で66%、8レベルの階段状の場合は最大で90%であり、波長785nmに対しては100%である。従って、波長635nmに関しては、モジュール1内の半導体レーザの出力が通常の光ヘッド装置と同じであるとすると、モジュール1内の光検出器の受光量は通常の光ヘッド装置の66%~90%になるが、従来の光ヘッド装置に比べればディスク7の再生信号のS/Nの低下量は少ない。

【0063】また、モジュール1内の光検出器の受光量が通常の光ヘッド装置と同じであるためには、モジュール1内の半導体レーザの出力を通常の光ヘッド装置の

1.1倍~1.5倍に高める必要があるが、従来の光へッド装置に比べれば容易に実現可能である。一方、波長785nmに関しては、ディスク8の再生信号のS/Nは通常と同程度であり、モジュール2内の半導体レーザの出力も通常と同程度で済み、ディスク8の再生だけでなく記録を行うことも可能である。

【0064】図11は図7に示した光合分波素子3に用いるホログラム26、及び図9に示した光合分波素子14に用いるホログラム33の干渉縞のパターンを示す。【0065】図12は図1及び図3に示した第一及び第二の実施の形態の光へッド装置に用いる開口制御素子5の一例の構成図で、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A'線に沿う断面図を示す。図12(a)、(b)に示すように、この開口制御素子5は、ガラス基板40上の中央部の円形領域の外側に誘電体多層膜41が形成され、円形領域の内側に位相補償膜であるSiO2膜42が形成された構成である。

【0066】円形領域の直径は、図1に示した第一の実施の形態の光ヘッド装置に用いる対物レンズ6、及び図3に示した第二の実施の形態の光ヘッド装置に用いる対物レンズ15の有効径よりも小さい。誘電体多層膜41は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。また、SiO2膜42は、波長635nmに対し、円形領域の外側の誘電体多層膜41及び空気中を通る光と、円形領域の内側のSiO2膜42を通る光の位相差を0に調整する働きをする。

【0067】すなわち、波長635nmの光は、開口制御素子5において、円形領域の外側、内側ともすべて透過する。一方、波長785nmの光は、開口制御素子5において、円形領域の外側ではすべて反射され、内側ではすべて透過する。

【0068】図13は図1及び図3に示した第一及び第二の実施の形態の光ヘッド装置に用いる開口制御素子5の別の例の構成図で、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A'線に沿う断面図を示す。図13(a)、

(b) に示すように、この開口制御素子 5 は、円形領域の外側に回折格子層である 5 i  $O_2$  膜 4 3 及び誘電体多層膜 4 4 が形成されたガラス基板 4 0 と、円形領域の内側に位相補償膜である 5 i  $O_2$  膜 4 7 が形成されたガラス基板 4 6 を、接着剤 4 5 を介して貼り合わせた構成である

【0069】円形領域の直径は、図1に示した第一の実施の形態の光ヘッド装置に用いる対物レンズ6、及び図3に示した第二の実施の形態の光ヘッド装置に用いる対物レンズ15の有効径よりも小さい。また、誘電体多層膜44は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。接着剤45と $SiO_2$ 膜43は屈折率がほぼ同じである。

【0070】SiO<sub>2</sub>膜43、誘電体多層膜44及び接

着剤45を組み合わせることにより、波長635nmの光はすべて透過し、波長785nmの光はすべて反射回折される。また、 $SiO_2$ 膜47は、波長635nmに対し、円形領域の外側の $SiO_2$ 膜43、誘電体多層膜44、接着剤45及び空気中を通る光と、円形領域の内側の接着剤45及び $SiO_2$ 膜47を通る光の位相差を0に調整する働きをする。

【0071】すなわち、波長635nmの光は、開口制御素子5において、円形領域の外側、内側ともすべて透過する。一方、波長785nmの光は、開口制御素子5において、円形領域の外側ではすべて反射回折され、内側ではすべて透過する。 $SiO_2$ 膜43のパターンは、直線状でなく同心円状等の他の形状でも構わない。

【0072】図1に示した第一の実施の形態に用いる対物レンズ6、及び図3に示した第二の実施の形態に用いる対物レンズ15の実効的な開口数は、波長635nmの光に対しては、対物レンズ6及び対物レンズ15の有効径で決まり、波長785nmの光に対しては、図12又は図13に示す構成の開口制御素子5における円形領域の直径で決まる。従って、例えばディジタルビデオディスク等に対する開口数を0.6、コンパクトディスク等に対する開口数を0.45というように、後者を前者よりも小さくすることが可能である。

【0073】図1に示した第一の実施の形態に用いる対物レンズ6、又は図3に示した第二の実施の形態に用いる対物レンズ15のみがアクチュエータによりトラッキング方向に駆動される場合は、往路において図12又は図13に示す構成の開口制御素子5を透過した波長785nmの光が、復路において光軸と開口制御素子5における円形領域の中心軸がずれるため、開口制御素子5をすべて透過することができず、光量損失が生じる。しかし、開口制御素子5を、対物レンズ6又は対物レンズ15と共にアクチュエータによりトラッキング方向に一体駆動することにより、このような光量損失を防止できる。

【0074】図2に示した構成の光合分波素子3における誘電体多層膜11、図4に示した構成の光合分波素子14における誘電体多層膜16、図5に示した構成の光合分波素子における誘電体多層膜21、図6に示した構成の光合分波素子おける誘電体多層膜25、図8に示した構成のホログラム26における誘電体多層膜28及び31、図10に示した構成のホログラム33における誘電体多層膜35及び38、図12に示した構成の開口制御素子5における誘電体多層膜41、及び図13に示した構成の開口制御素子5における誘電体多層膜44は、TiO2等の高屈折率層とSiO2等の低屈折率層を交互に奇数層堆積させることにより作製できる。

【0075】ここで、上記の高屈折率層と低屈折率層の屈折率を $n_1$ 、 $n_2$ 、厚さを $d_1$ 、 $d_2$ 、入射角を $\theta_1$ 、 $\theta_2$ とすると、波長635nmの光をすべて透過させ、波長

785 nmの光をすべて反射させる場合は $n_1 d_1/c$  o s  $\theta_1 = n_2 d_2/c$  o s  $\theta_2 = \lambda/4$  ( $\lambda = 785$  nm) とすればよく、また波長 635 nmの光をすべて反射させ、波長 785 nmの光をすべて透過させる場合は $n_1$   $d_1/c$  o s  $\theta_1 = n_2 d_2/c$  o s  $\theta_2 = \lambda/4$  ( $\lambda = 635$  nm) とすればよい。

【0076】図14は図1及び図3に示した各実施の形態の光へッド装置に用いるモジュール1及びモジュール2の一例の構成図を示す。このモジュールは、半導体レーザ48、光検出器49及びそれらを収納したパッケージ50と、パッケージ50の窓部にスペーサ53を挟んで設けられた回折光学素子51と、ホログラム光学素子52から構成される。回折光学素子51及びホログラム光学素子52は、ガラス基板上にSiO2でパターンが形成された構造であり、入射光の一部を透過、一部を回折させる働きをする。

【0077】このモジュールでは、半導体レーザ48からの出射光が、回折光学素子51で透過光と±1次回折光の三つの光に分けられ、それぞれホログラム光学素子52を約50%が透過してディスクに向かう。ディスクで反射された二つの光は、それぞれホログラム光学素子52で±1次回折光として約40%が回折され、回折光学素子51を透過して光検出器49で受光される。

【0078】図15(a)は回折光学素子51の干渉縞 のパターンを示す。回折光学素子51は中心付近の領域 54にのみパターンを有する。半導体レーザ48からの 出射光は領域54の内部を通り、ディスクからの反射光 は領域54の外部を通る。また、図15(b)はホログ ラム光学素子52の干渉縞のパターンを示す。このホロ グラム光学素子52はオフアクシスの同心円状のパター ンを有し、+1次回折光に対しては凸レンズ、-1次回 折光に対しては凹レンズとしての働きをする。 図16は 図15(a)の干渉縞のパターンを示す回折光学素子5 1及び図15(b)の干渉縞のパターンを示すホログラ ム光学素子52を用いた場合の、光検出器49の受光部 のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示し、図 16 (a) は平面図、図16 (b) は中央部の側面図を 示す。図16(a)、(b)に示すように、半導体レー ザ48は、光検出器49上にヒートシンク55を介して 設置されている。半導体レーザ48から側方に出射され た光は、ガラスのミラー56で反射されて図16(b) に示すように上方に向かう。

【0079】往路の回折光学素子51の透過光のうち、 復路のホログラム光学素子52の+1次回折光は、3分割された受光部57~59上に光スポット67を形成し、復路のホログラム光学素子52の-1次回折光は、3分割された受光部60~62上に光スポット68を形成する。また、往路の回折光学素子51の+1次回折光のうち、復路のホログラム光学素子52の+1次回折光は、それぞれ受光部63、64上に光スポット69、7 0を形成し、往路の回折光学素子51の-1次回折光の うち、復路のホログラム光学素子52の $\pm$ 1次回折光 は、それぞれ受光部65、66上に光スポット71、72を形成する。受光部57~59、63、65は集光点の後方に位置しており、受光部60~62、64、66 は集光点の前方に位置している。

【0080】受光部57~66によりそれぞれ光電変換して得られた電気信号のレベルをそれぞれV57~V66で表わすと、フォーカス誤差信号は公知のスポットサイズ法により、 $\{(V57+V59+V61)-(V58+V60+V62)\}$ の演算から得られ、トラック誤差信号は公知の3ビーム法により、 $\{(V63+V64)-(V65+V66)\}$ の演算から得られる。また、ディスクの再生信号は、(V57+V58+V59+V60+V61+V62)の演算から得られる。図17はホログラム光学素子52の別の干渉縞のパターンを示す。このホログラム光学素子52は二つの領域73、74に分割されている。

【0081】図18は図15(a)の干渉縞のパターンを示す回折光学素子51及び図17の干渉縞のパターンを示すホログラム光学素子52を用いた場合の、光検出器49の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す。半導体レーザ48の光検出器49への実装形態は図16と同様である。

【0082】図18において、往路の回折光学素子51の透過光のうち、復路のホログラム光学素子52の領域73からの+1次回折光は、2分割された受光部75、76の分割線上に光スポット87を形成し、領域74からの+1次回折光は、2分割された受光部77、78の分割線上に光スポット88を形成する。往路の回折光学素子51の透過光のうち、復路のホログラム光学素子52の領域73からの-1次回折光は、2分割された受光部79、80の分割線上に光スポット89を形成し、領域74からの-1次回折光は、2分割された受光部81、82の分割線上に光スポット90を形成する。

【0083】また、往路の回折光学素子51の+1次回 折光のうち、復路のホログラム光学素子52の領域7 3、74からの+1次回折光は、それぞれ受光部83上 に光スポット91、92を形成し、領域73、74から の-1次回折光は、それぞれ受光部84上に光スポット 93、94を形成する。往路の回折光学素子51の-1 次回折光のうち、復路のホログラム光学素子52の領域 73、74からの+1次回折光は、それぞれ受光部85 上に光スポット95、96を形成し、領域73、74か らの-1次回折光は、それぞれ受光部86上に光スポット 97、98を形成する。

【0084】受光部75~86によりそれぞれ光電変換して得られた電気信号レベルをそれぞれV75~V86で表わすと、フォーカス誤差信号は公知のフーコー法により、 $\{(V75+V78+V79+V82)-(V75+V78+V79+V82)\}$ 

6+V77+V80+V81) } の演算から得られ、ト ラック誤差信号は公知の3ピーム法により、 { (V83) +V84) - (V85+V86) } の演算から得られ る。また、ディスクの再生信号は、(V75+V76+ V77+V78+V79+V80+V81+V82) の 演算から得られる。

【0085】図19は本発明の光ヘッド装置の第三の実 施の形態の構成図を示す。同図中、図1と同一構成部分 には同一符号を付してある。図19において、モジュー ル99及びモジュール100には、後述するように半導 体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器 が内蔵されている。モジュール99内の半導体レーザの 波長は635nm、モジュール100内の半導体レーザ の波長は785 nmである。

【0086】モジュール99内の半導体レーザからの出 射光は、1/2波長板101、光合分波素子3、コリメ ータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子102、1/ 4波長板103、開口制御素子5を透過し、対物レンズ 6に平行光として入射し、ディジタルビデオディスク等 の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。デ ィスク7からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子 5、1/4波長板103を逆向きに通り、偏光性ホログ ラム光学素子102で±1次回折光として回折され、コ リメータレンズ4、光合分波素子3、1/2波長板10 1を逆向きに通り、モジュール99内の光検出器で受光 される。

【0087】一方、モジュール100内の半導体レーザ からの出射光は、光合分波素子3で反射され、コリメー

$$\eta_{00} = \cos^{2} (\phi_{0}/2) \tag{1}$$

$$\eta_{0e} = \cos^{2} (\phi_{e}/2) \tag{2}$$

$$\eta_{10} = (8/\pi^{2}) \sin^{2} (\phi_{0}/2) \tag{3}$$

$$\eta_{1e} = (8/\pi^{2}) \sin^{2} (\phi_{e}/2) \tag{4}$$

従って、波長635nmに対しては $\eta_{00}=1$ 、 $\eta_{0e}=$ 0、 $\eta_{10} = 0$ 、 $\eta_{1e} = 0$ . 81となり、波長785nm に対しては $\eta_{00}$ =1、 $\eta_{0e}$ =0.09、 $\eta_{10}$ =0、 $\eta_{1e}$ =0.74となる。

【0091】また、1/4波長板103における常光と 異常光の位相差を φとすると、1/4波長板103は波 長635nmに対して $\phi = \pi/2$ となるように設計され ているので、波長785nmに対しては $\phi$ =0.40 $\pi$ となる。1/4波長板103に直線偏光が入射したと き、1/4波長板103を往復した光の入射光と平行な 偏光成分、入射光と垂直な偏光成分の大きさは、それぞ  $n\cos^2\phi$ 、 $\sin^2\phi$ で表される。従って、波長63 5 nmに対しては $\cos^2 \phi = 0$ 、 $\sin^2 \phi = 1$ とな り、波長785nmに対しては $\cos^2 \phi = 0$ .09、  $\sin^2 \phi = 0$ . 91となる。

【0092】以上より、モジュール99内の半導体レー ザからの出射光は、1/2波長板101で偏光方向が9 0°回転し、偏光性ホログラム光学素子102に常光と

タレンズ4、偏光性ホログラム光学素子102、1/4 波長板103、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6 に発散光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚 さ1. 2mmのディスク8上に集光される。ディスク8 からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、1/ 4波長板103を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学 素子102で±1次回折光として回折され、コリメータ レンズ4、光合分波素子3を逆向きに通り、モジュール 100内の光検出器で受光される。 偏光性ホログラム光 学素子102、1/4波長板103及び開口制御素子5 は、対物レンズ6と共にアクチュエータによりフォーカ シング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0088】光合分波素子3の構成は図2に示した構成 と同じであり、開口制御素子5の構成は図12又は図1 3に示した構成と同じである。また、モジュール100 からコリメータレンズ4までの波長785 nmの光に対 する光路長は、モジュール99からコリメータレンズ4 までの波長635nmの光に対する光路長よりも短い。 【0089】偏光性ホログラム光学素子102のライン 部を通る光とスペース部を通る光の常光、異常光に対す る位相差をそれぞれ $\phi_{0}$ 、 $\phi_{e}$ とすると、偏光性ホログラ ム光学素子102は波長635nmに対して $\phi_0$ =0、  $\phi_e = \pi$ となるように設計されているので、波長785 nmに対しては $\phi_0 = 0$ 、 $\phi_e = 0$ .  $81\pi$ となる。この とき、常光、異常光に対する透過率をそれぞれ η 00、 η Oe、常光、異常光に対する±1次回折効率をそれぞれ n 10、 $\eta_{1e}$ とすると、次式が成り立つ。

[0090]

(2)

して入射してすべて透過し、1/4波長板103で直線 偏光から円偏光に変換されてディスク7に向かう。ディ スク7からの反射光は、1/4波長板103で円偏光か ら直線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子10 2に異常光として入射し、±1次回折光として81%が 回折されてモジュール99内の光検出器に向かう。

【0093】一方、モジュール100内の半導体レーザ からの出射光は、偏光性ホログラム光学素子102に常 光として入射してすべて透過し、1/4波長板103で 直線偏光から楕円偏光に変換されてディスク8に向か う。ディスク8からの反射光は、1/4波長板103で 楕円偏光から別の楕円偏光に変換されて偏光性ホログラ ム光学素子102に入射する。この楕円偏光の常光成 分、異常光成分の大きさはそれぞれ9%、91%であ り、±1次回折光として常光成分の9%、異常光成分の 74%が回折されてモジュール100内の光検出器に向 かう。

【0094】なお、図19に示した第三の実施の形態で

は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜11を有する光合分波素子3を用いているが、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。この場合、モジュール99とモジュール100の位置を入れ換えればよい。

【0095】図20は本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態の構成図を示す。同図中、図3と同一構成部分には同一符号を付してある。モジュール99及びモジュール100には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール99内の半導体レーザの波長は635nm、モジュール100内の半導体レーザの波長は785nmである。

【0096】モジュール99内の半導体レーザからの出射光は、光合分波素子14で反射され、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に収束光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折され、コリメータレンズ4、光合分波素子14を逆向きに通り、モジュール99内の光検出器で受光される。

【0097】一方、モジュール100内の半導体レーザからの出射光は、1/2波長板104、光合分波素子14、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に平行光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折され、コリメータレンズ4、光合分波素子14、1/2波長板104を逆向きに通り、モジュール100内の光検出器で受光される。偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106及び開口制御素子5は、対物レンズ15と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0098】光合分波素子14の構成は図4に示した構成と同じであり、開口制御素子5の構成は図12又は図13に示した構成と同じである。また、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する光路長は、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する光路長よりも長い。

【0099】偏光性ホログラム光学素子105のライン部を通る光とスペース部を通る光の常光、異常光に対する位相差をそれぞれ $\phi_0$ 、 $\phi_e$ とすると、偏光性ホログラ

ム光学素子105は波長785nmに対して $\phi_0$ =0、 $\phi_e$ = $\pi$ となるように設計されているので、波長635nmに対しては $\phi_0$ =0、 $\phi_e$ = $1.24\pi$ となる。このとき、常光、異常光に対する透過率をそれぞれ $\eta_{00}$ 、 $\eta_{0e}$ 、常光、異常光に対する±1次回折効率をそれぞれ $\eta_{10}$ 、 $\eta_{1e}$ とすると、前記(1)式~(4)式が成り立つ。

【0 1 0 0】従って、波長6 3 5 nmに対しては  $\eta_{00}$  = 1、 $\eta_{0e}$  = 0. 1 3、 $\eta_{10}$  = 0、 $\eta_{1e}$  = 0. 7 0 となり、波長7 8 5 nmに対しては  $\eta_{00}$  = 1、 $\eta_{0e}$  = 0、 $\eta_{10}$  = 0、 $\eta_{1e}$  = 0. 8 1 となる。

【0101】また、1/4被長板106における常光と 異常光の位相差を $\phi$ とすると、1/4被長板106は被長785nmに対して $\phi$ = $\pi/2$ となるように設計されているので、波長635nmに対しては $\phi$ =0.62 $\pi$ となる。1/4被長板106に直線偏光が入射したとき、1/4被長板106を往復した光の入射光と平行な偏光成分、入射光と垂直な偏光成分の大きさは、それぞれ $\cos^2\phi$ 、 $\sin^2\phi$ で表される。従って、波長635nmに対しては $\cos^2\phi$ 0.87となり、波長785nmに対しては $\cos^2\phi$ =0、 $\sin^2\phi$ =1となる。

【0102】以上より、モジュール99内の半導体レーザからの出射光は、偏光性ホログラム光学素子105に常光として入射してすべて透過し、1/4波長板106で直線偏光から楕円偏光に変換されてディスク7に向かう。ディスク7からの反射光は、1/4波長板106で楕円偏光から別の楕円偏光に変換されて偏光性ホログラム光学素子105に入射する。この楕円偏光の常光成分、異常光成分の大きさはそれぞれ13%、87%であり、±1次回折光として常光成分の13%、異常光成分の70%が回折されてモジュール99内の光検出器に向かう。

【0103】一方、モジュール100内の半導体レーザからの出射光は、1/2波長板104で偏光方向が90°回転し、偏光性ホログラム光学素子105に常光として入射してすべて透過し、1/4波長板106で直線偏光から円偏光に変換されてディスク8に向かう。ディスク8からの反射光は、1/4波長板106で円偏光から直線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子105に異常光として入射し、±1次回折光として81%が回折されてモジュール100内の光検出器に向かう。

【0104】なお、図20に示す第四の実施の形態の構成では、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜16を有する光合分波素子14を用いているが、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。この場合、モジュール99とモジュール100の位置を入れ換えればよい。

【0105】次に、図19及び図20に示した第三及び 第四の実施の形態の光ディスク装置に用いる各構成要素 について詳細に説明する。図21はモジュール99及び モジュール100の一例の構成図を示す。このモジュー ルは、半導体レーザ107、光検出器108及びそれら を収納したパッケージ50から構成される。半導体レー ザ107からの出射光は、偏光性ホログラム光学素子1 02又は105を透過してディスクに向かう。ディスク からの反射光は、偏光性ホログラム光学素子102又は 105で±1次回折光として回折されて光検出器108 で受光される。図22(a)及び(b)は偏光性ホログ ラム光学素子102、105の干渉縞のパターン及び断 面図を示す。偏光性ホログラム光学素子102、105 は、図22(b)に示すように複屈折性を有するニオブ 酸リチウム基板109上に、プロトン交換領域110と Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>111でパターンが形成された構造である。

【0106】この偏光性ホログラム光学素子102、105の干渉縞のパターンは図22(a)に示すように、四つの領域112~115に分割されている。各領域はオフアクシスの同心円状のパターンを有し、領域112、115は+1次回折光に対しては凸レンズ、-1次回折光に対しては凹レンズとしての働きをし、領域113、114は+1次回折光に対しては凹レンズ、-1次回折光に対しては凸レンズとしての働きをする。また、偏光性ホログラム光学素子102、105の光学軸は、それぞれ図中のY方向、X方向に設定されている。

【0107】図23は図22に示す構成の偏光性ホログラム光学素子102又は105を用いた場合の、光検出器108の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す。半導体レーザ107の光検出器108への実装形態は図16と同様である。偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域112からの+1次回折光は、2分割された受光部116、117上に光スポット128を形成し、領域112からの-1次回折光は受光部124上に光スポット132を形成する。

[0108]

【0109】偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域113からの+1次回折光は、2分割された受光部118、119上に光スポット129を形成し、領域113からの-1次回折光は受光部125上に光スポット133を形成する。偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域114からの+1次回折光は、2分割された受光部120、121上に光スポット130を形成し、領域114からの-1次回折光は受光部128上に光スポット134を形成する。

【0110】また、偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域115からの+1次回折光は、2分割された受光部122、123上に光スポット131を形成し、領域115からの-1次回折光は受光部127上に光スポット135を形成する。受光部116、117、

122、123、125、126は集光点の後方に位置しており、受光部118、119、120、121、124、127は集光点の前方に位置している。

【0111】受光部116~127によりそれぞれ光電変換されて得られた電気信号のレベルをそれぞれV116~V127で表わすと、フォーカス誤差信号は公知のスポットサイズ法により、{(V116+V118+V121+V123)} の演算から得られ、トラック誤差信号は公知のプッシュプル法により、{(V124+V126)} の演算から得られる。また、ディスクの再生信号は、(V124+V125+V126+V127)の演算から得られる。トラック誤差信号は公知のヘテロダイン法により、{(V124+V127)} の演算から得られる。トラック誤差信号は公知のヘテロダイン法により、{(V124+V127)} (V124+V127) の (V125+V126) をディスクの再生信号の立ち上がり点、立ち下がり点でサンプルホールドすることによっても得られる。

【0112】図24は偏光性ホログラム光学素子102、105の別の干渉縞のパターンを示す。この偏光性ホログラム光学素子102、105の干渉縞のパターンは四つの領域136~139に分割されている。また、偏光性ホログラム光学素子102、105の光学軸は、それぞれ図中のY方向、X方向に設定されている。

【0113】図25は図24に示した構成の偏光性ホログラム光学素子102又は105を用いた場合の、光検出器108の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す。半導体レーザ107の光検出器108への実装形態は図16と同様である。偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域136からの+1次回折光は、2分割された受光部140、141の分割線上に光スポット152を形成し、領域136からの-1次回折光は受光部148上に光スポット156を形成する。

【0114】偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域137からの+1次回折光は、2分割された受光部142、143の分割線上に光スポット153を形成し、領域137からの-1次回折光は受光部149上に光スポット157を形成する。偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域138からの+1次回折光は、2分割された受光部144、145の分割線上に光スポット154を形成し、領域138からの-1次回折光は受光部150上に光スポット158を形成する。また、偏光性ホログラム光学素子102又は105の領域139からの+1次回折光は、2分割された受光部146、147の分割線上に光スポット155を形成し、領域139からの-1次回折光は受光部151上に光スポット159を形成する。

【0115】受光部140~151によりそれぞれ光電変換して得られた電気信号のレベルをそれぞれV140~V151で表わすと、フォーカス誤差信号は公知のフ

ーコー法により、 $\{(V140+V142+V145+V147)-(V141+V143+V144+V146)\}$ の演算から得られ、トラック誤差信号は公知のプッシュプル法により、 $\{(V148+V150)-(V149+V151)\}$ の演算から得られる。また、ディスクの再生信号は、(V148+V149+V150+V151)の演算から得られる。トラック誤差信号は公知のヘテロダイン法により、 $\{(V148+V151)-(V149+V150)\}$ をディスクの再生信号の立ち上がり点、立ち下がり点でサンプルホールドすることによっても得られる。

【0116】図1、図3、図19及び図20に示した各 実施の形態の光ヘッド装置は、いずれも小型化のために 半導体レーザと光検出器を内蔵した二個のモジュールを 用いた構成であるが、半導体レーザと光検出器を別々に 設けた二組のプロックを用いた構成も可能である。

【0117】図26は本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態の構成図を示す。モジュール100には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。半導体レーザ160の出射光の波長は635nm、モジュール100内の半導体レーザの出射光の波長は785nmである。

【0118】半導体レーザ160からの出射光は、光合分波/光路制御素子161、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子102、1/4波長板103、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に平行光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、1/4波長板103を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子102で±1次回折光として回折され、コリメータレンズ4を逆向きに通り、光合分波/光路制御素子161で反射され、モジュール100内の光検出器で受光される。

【0119】一方、モジュール100内の半導体レーザからの出射光は、光合分波/光路制御素子161で反射され、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子102、1/4波長板103、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に発散光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、1/4波長板103を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子102で±1次回折光として回折され、コリメータレンズ4、光合分波/光路制御素子161を逆向きに通り、モジュール100内の光検出器で受光される。偏光性ホログラム光学素子102、1/4波長板103及び開口制御素子5は、対物レンズ6と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0120】開口制御素子5の構成は図12又は図13 に示す通りである。また、偏光性ホログラム光学素子1 02及び1/4波長板103の働きは、図19に示す実施の形態と同様である。

【0121】図27は図26に示した第五の実施の形態で用いられる光合分波/光路制御素子161の一例の構成図を示す。図27(a)~(c)に示すように、光合分波/光路制御素子161は、プリズム162、プリズム163及びプリズム164を、誘電体多層膜165及び誘電体多層膜166を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜165は、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。また、誘電体多層膜166は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

【0122】これにより、図27(a)に示すように、半導体レーザ160を出射して光合分波/光路制御素子161のプリズム162に入射した波長635nmの入射光168は、誘電体多層膜165にP偏光として入射してすべて透過し、更に誘電体多層膜166をすべて透過し、光合分波/光路制御素子161のプリズム164を出射する。また、図27(b)に示すように、ディスク7で反射されて光合分波/光路制御素子161のプリズム164に入射した波長635nmの入射光169は、誘電体多層膜166をすべて透過し、誘電体多層膜165にS偏光として入射してすべて反射され、プリズム163の反射膜167ですべて反射され、再び誘電体多層膜166をすべて透過して光合分波/光路制御素子161のプリズム164を出射する。

【0123】一方、図27 (c) に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子161のプリズム164に入射した波長785 nmの入射光170は、誘電体多層膜166ですべて反射されてプリズム164を出射する。ディスク8で反射されて光合分波/光路制御素子161のプリズム164 に入射した波長785 nmの光は、入射光170と同じ経路を逆に通ってプリズム164を出射する。

【0124】図28は本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態の構成図を示す。この第六の実施の形態は、図26に示した第五の実施の形態に用いる光合分波/光路制御素子161を、光合分波/光路制御素子171で置き換えた構成である。

【0125】図29はこの光合分波/光路制御素子171の一例の構成図を示す。図29(a)~(c)に示すように、光合分波/光路制御素子171は、プリズム172、プリズム173及びプリズム174を、誘電体多層膜175及び誘電体多層膜176を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜175は、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。また、誘電体多層膜176は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

【0126】図29(a)に示すように、半導体レーザ160を出射して光合分波/光路制御素子171のプリズム172に入射した波長635nmの入射光168は、誘電体多層膜175にP偏光として入射してすべて透過し、更に誘電体多層膜176をすべて透過して光合分波/光路制御素子171のプリズム174を出射する。また、図29(b)に示すように、ディスク7で反射されて光合分波/光路制御素子171のプリズム174に入射した波長635nmの入射光169は、誘電体多層膜176をすべて透過し、誘電体多層膜175にS偏光として入射してすべて反射され、プリズム173と空気の境界面で2回全反射され、再び誘電体多層膜176をすべて透過してプリズム174を出射する。

【0127】一方、図29(c)に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子171のプリズム174に入射した波長785 nmの入射光170は、誘電体多層膜176ですべて反射されてプリズム174を出射する。ディスク8で反射されて光合分波/光路制御素子171に入射した波長785 nmの光は、入射光170と同じ経路を逆に通って光合分波/光路制御素子171を出射する。

【0128】図26及び図28に示した第五及び第六の実施の形態では、モジュール100から光合分波/光路制御素子161又は171までの距離は、半導体レーザ160から光合分波/光路制御素子161又は171までの距離よりも短い。この第五及び第六の実施の形態で、図27に示す構成の光合分波/光路制御素子161又は図29に示す構成の光合分波/光路制御素子161又は図29に示す構成の光合分波/光路制御素子171を用いると、半導体レーザ160からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長と、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を等しくすることができ、かつ、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、それらよりも短くすることができる。

【0129】図30は本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態の構成図を示す。モジュール99には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール99内の半導体レーザの波長は635nm、半導体レーザ177の波長は785nmである。

【0130】モジュール99内の半導体レーザからの出射光は、光合分波/光路制御素子178で反射され、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に収束光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。デイスク7からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折

され、コリメータレンズ4、光合分波/光路制御素子178を逆向きに通り、モジュール99内の光検出器で受光される。

【0131】一方、半導体レーザ177からの出射光は、光合分波/光路制御素子178、コリメータレンズ4、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に平行光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折され、コリメータレンズ4を逆向きに通り、光合分波/光路制御素子178で反射され、モジュール99内の光検出器で受光される。偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106及び開口制御素子5は、対物レンズ15と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0132】開口制御素子5の構成は図12又は図13に示した構成と同じである。また、偏光性ホログラム光学素子105及び1/4波長板106の働きは、図20に示した第四の実施の形態と同様である。

【0133】図31は図30に示した第七の実施の形態の光ヘッド装置で用いる光合分波/光路制御素子178の一例の構成図を示す。図31(a)~(c)に示すように光合分波/光路制御素子178は、プリズム162、プリズム163及びプリズム164を、誘電体多層膜179及び誘電体多層膜180を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜179は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。

【0134】図31 (a)に示すように、モジュール99内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子178のプリズム164に入射した波長635nmの入射光181は、誘電体多層膜180をすべて透過し、プリズム163の反射膜167及び誘電体多層膜179ですべて反射され、再び誘電体多層膜180をすべて透過し、プリズム164を出射する。また、ディスク7で反射されて光合分波/光路制御素子178のプリズム164に入射した波長635nmの光は、入射光181と同じ経路を逆に通って光合分波/光路制御素子178のプリズム164を出射する。

【0135】一方、図31(b)に示すように、半導体レーザ177を出射して光合分波/光路制御素子178のプリズム162に入射した波長785nmの入射光182は、誘電体多層膜179をすべて透過し、更に誘電体多層膜180にP偏光として入射し、すべて透過して

プリズム 164 を出射する。また、図 31(c) に示すように、ディスク 8 で反射されて光合分波/光路制御素子 178 のプリズム 164 に入射した波長 785 nmの入射光 183 は、誘電体多層膜 180 にS偏光として入射し、すべて反射されプリズム 164 を出射する。

【0136】図32は本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態の構成図を示す。この第八の実施の形態は、図30に示した第七の実施の形態に用いる光合分波/光路制御素子178を、光合分波/光路制御素子184で置き換えた構成である。

【0137】図33はこの光合分波/光路制御素子184の一例の構成図を示す。図33(a)~(c)に示すように、光合分波/光路制御素子184は、プリズム172、プリズム173及びプリズム174を、誘電体多層膜185及び誘電体多層膜186を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜185は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。

【0138】図33(a)に示すように、モジュール99内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子184のプリズム174に入射した波長635nmの入射光181は、誘電体多層膜186をすべて透過し、プリズム173と空気の境界面で2回全反射され、誘電体多層膜185ですべて反射され、再び誘電体多層膜186をすべて透過して光合分波/光路制御素子184を出射する。また、ディスク7で反射されて光合分波/光路制御素子184のプリズム174に入射した波長635nmの光は、入射光181と同じ経路を逆に通って光合分波/光路制御素子184のプリズム174を出射する。

【0139】一方、図33(b)に示すように、半導体レーザ177を出射して光合分波/光路制御素子184のプリズム172に入射した波長785nmの入射光182は、誘電体多層膜185及びプリズム173をすべて透過し、誘電体多層膜186にP偏光として入射し、すべて透過してプリズム174を出射する。また、図33(c)に示すように、ディスク8で反射されて光合分波/光路制御素子184のプリズム174に入射した波長785nmの入射光183は、誘電体多層膜186にS偏光として入射し、すべて反射されてプリズム174を出射する。

【0140】図30及び図32に示した第七及び第八の 実施の形態の構成では、半導体レーザ177から光合分 波/光路制御素子178又は184までの距離と、モジュール99から光合分波/光路制御素子178又は18 4までの距離は等しい。この構成で、図31に示す構成 の光合分波/光路制御素子178又は図33に示す構成 の光合分波/光路制御素子184を用いると、半導体レーザ177からコリメータレンズ4までの波長785 nmの光に対する実効的な光路長と、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長785 nmの光に対する実効的な光路長を等しくすることができ、かつ、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長635 nmの光に対する実効的な光路長を、それらよりも長くすることができる。

【0141】図34は図26に示した第五の実施の形態の光ヘッド装置に用いる光合分波/光路制御素子161の別の例の構成図を示す。図34(a)~(c)に示すように、この光合分波/光路制御素子161は、プリズム9及びプリズム10を、ホログラム187を介して貼り合わせた構成である。

【0142】図34(a)に示すように、半導体レーザ 160を出射して光合分波/光路制御素子161のプリ ズム9に入射した波長635nmの入射光168は、ホ ログラム187にP偏光として入射し、すべて透過して 光合分波/光路制御素子を出射する。また、図34

(b) に示すように、ディスク7で反射されて光合分波 /光路制御素子161のプリズム10に入射した波長6 35nmの入射光169は、ホログラム187にS偏光 として入射し、+1次回折光として反射回折されて光合 分波/光路制御素子を出射する。

【0143】一方、図34 (c) に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子161のプリズム10に入射した波長785 n mの入射光170は、ホログラム187ですべて反射されてプリズム10を出射する。ディスク8で反射されて光合分波/光路制御素子161のプリズム10に入射した波長785 n m の光は、入射光170と同じ経路を逆に通ってプリズム10を出射する。

【0144】図35は図34中のホログラム187の各例の構成図を示す。ホログラム187は、図35(a)に示すように、プリズム9の斜面にホログラム層である  $SiO_2$ 膜188及び誘電体多層膜189が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜191が形成され、両者の間に接着剤190が充填された構成である。また、図35(b)に示すホログラム187は、プリズム9の斜面にホログラム層である $SiO_2$ 膜192及び誘電体多層膜193が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜193が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜195が形成され、両者の間に接着剤194が充填された構成である。

【0145】誘電体多層膜189及び193は、波長635 nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。また、誘電体多層膜191及び195は、波長635 nmの光をすべて反射させる働きをする。接着剤190及び194と $SiO_2$ 膜188及び192は屈折率がほぼ同じである。

【0146】SiO<sub>2</sub>膜188又は192、誘電体多層膜189又は193、及び接着剤190又は194を組み合わせることにより、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分はすべて透過し、S偏光成分はすべて反射回折される。ホログラム187は、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをする。

【0147】図35(a)、(b)に示すように、半導体レーザ160を出射してホログラム187に入射した波長635nmの入射光168は、SiO2膜188又は192、誘電体多層膜189又は193、及び接着剤190又は194にP偏光として入射してすべて透過し、誘電体多層膜191又は195をすべて透過してホログラム187を出射する。また、ディスク7で反射されてホログラム187に入射した波長635nmの入射光169は、誘電体多層膜191又は195をすべて透過し、接着剤190又は194、及び誘電体多層膜189又は193にS偏光として入射し、+1次回折光として反射回折され、再び誘電体多層膜191又は195をすべて透過してホログラム187を出射する。

【0148】一方、モジュール100内の半導体レーザを出射してホログラム187に入射した波長785nmの入射光170は、誘電体多層膜191又は195ですべて反射されてホログラム187を出射する。ディスク8で反射されてホログラム187に入射した波長785nmの光は、入射光170と同じ経路を逆に通ってホログラム187を出射する。

【0149】図35(a)に示すように、 $SiO_2$ 膜188の断面が矩形状の場合、+1次回折光に対する回折効率は最大で40.5%である。これに対し、図35(b)に示すように、 $SiO_2$ 膜192の断面を階段状にすることにより、+1次回折光に対する回折効率が高くなる。4レベルの階段状の場合は最大で81%、8レベルの階段状の場合は最大で85%

【0150】図26に示した第五の実施の形態の構成では、モジュール100から光合分波/光路制御素子161までの距離は、半導体レーザ160から光合分波/光路制御素子161までの距離よりも短い。しかし、図34に示す構成の光合分波/光路制御素子を光合分波/光路制御素子161として用いると、ディスク7で反射された波長635nmの光に対する集光点は、ディスク8で反射された波長785nmの光に対する集光点よりも光合分波/光路制御素子に近付く。

【0151】従って、半導体レーザ160からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長と、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を等しくすることができ、かつ、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、それらよりも短くすることができる。

【0152】図36は図30に示した第七の実施の形態

の光ヘッド装置に用いる光合分波/光路制御素子178の別の構成図を示す。この光合分波/光路制御素子は、図 $36(a)\sim(c)$ に示すように、プリズム9及びプリズム10を、ホログラム196を介して貼り合わせた構成である。

【0153】図36(a)に示すように、モジュール99内の半導体レーザを出射して光合分波/光路制御素子178のプリズム10に入射した波長635nmの入射光181は、ホログラム196で+1次回折光として反射回折されてプリズム10を出射する。また、ディスク7で反射されて光合分波/光路制御素子178のプリズム10に入射した波長635nmの光は、入射光181と同じ経路を逆に通ってプリズム10を出射する。

【0154】一方、図36(b)に示すように、半導体レーザ177を出射して光合分波/光路制御素子178のプリズム9に入射した波長785nmの入射光182は、ホログラム196にP偏光として入射し、すべて透過し更にプリズム10を透過して出射する。また、図36(c)に示すように、ディスク8で反射されて光合分波/光路制御素子178のプリズム10に入射した波長785nmの入射光183は、ホログラム196にS偏光として入射し、すべて反射されてプリズム10を出射する。

【0155】図37は図36中のホログラム196の各例の構成図を示す。ホログラム196は、図37(a)に示すように、プリズム9の斜面にホログラム層である $SiO_2$ 膜197及び誘電体多層膜198が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜200が形成され、両者の間に接着剤199が充填された構成である。また、図37(b)に示すホログラム196は、プリズム9の斜面にホログラム層である $SiO_2$ 膜201及び誘電体多層膜202が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜204が形成され、プリズム10の斜面に誘電体多層膜204が形成され、両者の間に接着剤203が充填された構成である。

【0156】誘電体多層膜198及び202は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる働きをする。また、誘電体多層膜200及び204は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする。接着剤199及び203とSiO2膜197及び201は屈折率がほぼ同じである。

【0157】  $SiO_2$ 膜 197 又は 201、誘電体多層 膜 198 又は 202、及び接着 剤 199 又は 203 を組 み合わせることにより、波長 635 nmの光はすべて反射回折され、波長 785 nmの光はすべて透過する。ホログラム 196 は、+1 次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをする。

【0158】モジュール99内の半導体レーザを出射してホログラム196に入射した波長635nmの入射光

181は、誘電体多層膜200又は204をすべて透過し、接着剤199又は203、及び誘電体多層膜198又は202で+1次回折光として反射回折され、再び誘電体多層膜200又は204をすべて透過してホログラム196を出射する。ディスク7で反射されてホログラム196に入射した波長635nmの光は、入射光181と同じ経路を逆に通ってホログラム196を出射する。

【0159】一方、半導体レーザ177を出射してホログラム196に入射した波長785nmの入射光182は、SiO 197又は201、誘電体多層膜198又は202、及び接着剤199又は203をすべて透過し、誘電体多層膜200又は204にP偏光として入射し、すべて透過してホログラム196を出射する。ディスク8で反射されてホログラム196に入射した波長785nmの入射光183は、誘電体多層膜200又は204にS偏光として入射し、すべて反射されてホログラム196を出射する。

【0160】図37(a)に示すように、Si $O_2$ 膜197の断面が矩形状の場合、+1次回折光に対する回折効率は最大で40.5%である。これに対し、図37

(b) に示すように、 $SiO_2$ 膜201の断面を階段状にすることにより、+1次回折光に対する回折効率が高くなる。4レベルの階段状の場合は最大で81%、8レベルの階段状の場合は最大で95%である。

【0161】図30に示した第七の実施の形態の構成では、半導体レーザ177から光合分波/光路制御素子178までの距離と、モジュール99から光合分波/光路制御素子178までの距離は等しい。しかし、図36に示す構成の光合分波/光路制御素子を光合分波/光路制御素子178として用いると、ディスク7で反射された波長635nmの光に対する集光点は、ディスク8で反射された波長785nmの光に対する集光点よりも光合分波/光路制御素子178に近付く。

【0162】従って、半導体レーザ177からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長と、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を等しくすることができ、かつ、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、それらよりも長くすることができる。

【0163】図1、図19、図26及び図28に示した各実施の形態の光ヘッド装置の構成では、コリメータレンズ4及び対物レンズ6からなるレンズ系を用いているが、対物レンズのみからなるレンズ系を用いた構成も可能である。また、図3、図20、図30及び図32に示した各実施の形態の光ヘッド装置の構成では、コリメータレンズ4及び対物レンズ15からなるレンズ系を用いているが、対物レンズのみからなるレンズ系を用いた構成も可能である。

【0164】図38は本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態の構成図を示す。モジュール100には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。半導体レーザ160の出射光の波長は635nm、モジュール100内の半導体レーザの出射光の波長は785nmである。

【0165】半導体レーザ160からの出射光は、コリメータレンズ205、光合分波素子206、偏光性ホログラム光学素子102、1/4波長板103、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に平行光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、1/4波長板103を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子102で±1次回折光として回折され、光合分波素子206で反射され、コリメータレンズ4を透過し、光路制御素子207で反射され、モジュール100内の光検出器で受光される。

【0166】一方、モジュール100内の半導体レーザ からの出射光は、光路制御素子207で反射され、コリ メータレンズ4を透過し、光合分波素子206で反射さ れ、偏光性ホログラム光学素子102、1/4波長板1 03、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に発散光 として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2 mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反 射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、1/4波長板 103を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子10 2で±1次回折光として回折され、光合分波素子20 6、コリメータレンズ4、光路制御素子207を逆向き に通り、モジュール100内の光検出器で受光される。 【0167】偏光性ホログラム光学素子102、1/4 波長板103及び開口制御素子5は、対物レンズ6と共 にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッ キング方向に一体駆動される。 開口制御素子5の構成は 図12又は図13に示した構成と同じである。また、偏 光性ホログラム光学素子102及び1/4波長板103

【0168】図39は図38の第九の実施の形態の光へッド装置で用いる光合分波素子206の一例の構成図を示す。図39(a)~(c)に示すように、光合分波素子206は、プリズム9及びプリズム10を、誘電体多層膜208を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜208は、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

の働きは、図19に示した第三の実施の形態と同様であ

る。

【0169】図39(a)に示すように、半導体レーザ 160を出射して光合分波素子206のプリズム9に入 射した波長635nmの入射光209は、誘電体多層膜 208にP偏光として入射し、すべて透過し更にプリズ ム10を透過して出射する。図39(b)に示すように、ディスク7で反射されて光合分波素子206のプリズム10に入射した波長635nmの入射光210は、誘電体多層膜208にS偏光として入射し、すべて反射されてプリズム10を出射する。

【0170】一方、図39(c)に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光合分波素子206のプリズム10に入射した波長785nmの入射光211は、誘電体多層膜208ですべて反射されてプリズム10を出射する。ディスク8で反射されて光合分波素子206のプリズム10に入射した波長785nmの光は、入射光211と同じ経路を逆に通ってプリズム10を出射する。

【0171】図40は図38の第九の実施の形態の光へッド装置で用いる光路制御素子207の一例の構成図を示す。図40(a)及び(b)に示すように、光路制御素子207は、プリズム212及びプリズム213を、誘電体多層膜214を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜214は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

【0172】図40(a)に示すように、ディスク7で 反射されて光路制御素子207のプリズム212に入射 した波長635nmの入射光217は、誘電体多層膜2 14をすべて透過し、プリズム213の反射膜215及 び反射膜216ですべて反射され、再び誘電体多層膜2 14をすべて透過してプリズム212を出射する。

【0173】一方、図40 (b) に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光路制御素子207のプリズム212に入射した波長785nmの入射光218は、誘電体多層膜214ですべて反射されてプリズム212を出射する。また、ディスク8で反射されて光路制御素子207のプリズム212に入射した波長785nmの光は、入射光218と同じ経路を逆に通ってプリズム212を出射する。

【0174】図41は本発明の光ヘッド装置の第十の実施の形態の構成図を示す。この第十の実施の形態の光ヘッド装置は、図38に示した第九の実施の形態の光ヘッド装置に用いる光路制御素子207を、光路制御素子219で置き換えた構成である。

【0175】図42は図41の第十の実施の形態の光へッド装置で用いる光路制御素子219の構成を示す。光路制御素子219は、プリズム220及びプリズム221を、誘電体多層膜222を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜222は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。

【0176】図42(a)に示すように、ディスク7で 反射されて光路制御素子219のプリズム220に入射 した波長635nmの入射光217は、誘電体多層膜2 22をすべて透過し、プリズム221と空気の境界面で3回全反射され、再び誘電体多層膜222をすべて透過してプリズム220を出射する。

【0177】一方、図42(b)に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光路制御素子219のプリズム220に入射した波長785nmの入射光218は、誘電体多層膜222ですべて反射されてプリズム220を出射する。また、ディスク8で反射されて光路制御素子219のプリズム220に入射した波長785nmの光は、入射光218と同じ経路を逆に通ってプリズム220を出射する。

【0178】図38及び図41に示した第九及び第十の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、半導体レーザ160からコリメータレンズ205までの距離はコリメータレンズ205の焦点距離と等しく、モジュール100からコリメータレンズ4までの距離はコリメータレンズ4の焦点距離よりも短い。この構成で、図40に示す構成の光路制御素子207又は図42に示す構成の光路制御素子219を用いると、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、コリメータレンズ4の焦点距離と等しくすることができ、かつ、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、それよりも短くすることができる。

【0179】図38及び図41に示した第九及び第十の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜208を有する光合分波素子206を用いているが、波長635nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。

【0180】この場合、半導体レーザ160及びコリメータレンズ205からなるプロックと、モジュール100、光路制御素子207又は219、及びコリメータレンズ4からなるプロックの位置を入れ換え、半導体レーザ160を出射した波長635nmの光を、光合分波素子における誘電体多層膜にS偏光として入射させればよい。

【0181】図43は本発明の光ヘッド装置の第十一の実施の形態の構成図を示す。モジュール99には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール99内の半導体レーザの出射光の波長は635nm、半導体レーザ177の出射光の波長は785nmである。

【0182】モジュール99内の半導体レーザからの出射光は、光路制御素子207で反射され、コリメータレンズ4を透過し、光合分波素子223で反射され、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開

口制御素子5を透過し、対物レンズ15に収束光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6 mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折され、光合分波素子223、コリメータレンズ4、光路制御素子207を逆向きに通り、モジュール99内の光検出器で受光される。

【0183】一方、半導体レーザ177からの出射光は、コリメータレンズ205、光合分波素子223、偏光性ホログラム光学素子105、1/4波長板106、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に平行光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、1/4波長板106を逆向きに通り、偏光性ホログラム光学素子105で±1次回折光として回折され、光合分波素子223で反射され、コリメータレンズ4を透過し、光路制御素子207で反射され、モジュール99内の光検出器で受光される。

【0184】偏光性ホログラム光学素子105、1/4 波長板106及び開口制御素子5は、対物レンズ15と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。開口制御素子5の構成は図12又は図13に示した構成と同じである。また、偏光性ホログラム光学素子105及び1/4波長板106の働きは、図20に示した第四の実施の形態と同様である。

【0185】図44は図43の第十一の実施の形態の光へッド装置で用いる光合分波素子223の一例の構成図を示す。図44(a)~(c)に示すように、光合分波素子223は、プリズム9及びプリズム10を、誘電体多層膜224を介して貼り合わせた構成である。誘電体多層膜224は、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる働きをする

【0186】図44(a)に示すように、モジュール99内の半導体レーザを出射して光合分波素子223のプリズム10に入射した波長635nmの入射光225は、誘電体多層膜224ですべて反射されてプリズム10を出射する。また、ディスク7で反射されて光合分波素子223のプリズム10に入射した波長635nmの光は、入射光225と同じ経路を逆に通ってプリズム10を出射する。

【0187】一方、図44(b)に示すように、半導体レーザ177を出射して光合分波素子223のプリズム9に入射した波長785nmの入射光226は、誘電体多層膜224にP偏光として入射し、すべて透過し更にプリズム10を透過して出射する。また、図44(c)

に示すように、ディスク8で反射されて光合分波素子223のプリズム10に入射した波長785nmの入射光227は、誘電体多層膜224にS偏光として入射し、すべて反射されてプリズム10を出射する。

【0188】図45は本発明の光ヘッド装置の第十二の実施の形態の構成図を示す。この第十二の実施の形態の光ヘッド装置は、図43に示した第十一の実施の形態の光ヘッド装置に用いる光路制御素子207を、光路制御素子219で置き換えた構成である。図43に示す第十二の実施の形態の光ヘッド装置に用いる光路制御素子207の構成は、図40に示した構成と同じであり、光路制御素子219の構成は図42に示した構成と同じである。

【0189】図43及び図45に示した第十一及び第十二の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、半導体レーザ177からコリメータレンズ205までの距離はコリメータレンズ205の焦点距離と等しく、モジュール99からコリメータレンズ4までの距離はコリメータレンズ4の焦点距離と等しい。この構成で、図40に示す構成の光路制御素子207又は図42に示す構成の光路制御素子219を用いると、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、コリメータレンズ4の焦点距離と等しくすることができ、かつ、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、それよりも長くすることができる。

【0190】図43及び図45に示した第十一及び第十二の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、波長635 nmの光をすべて反射させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる誘電体多層膜224を有する光合分波素子223を用いているが、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの入射光のうち、P偏光成分をすべて透過させ、S偏光成分をすべて反射させる誘電体多層膜を有する光合分波素子を用いた構成も可能である。

【0191】この場合、半導体レーザ177及びコリメータレンズ205からなるプロックと、モジュール99、光路制御素子207又は219、及びコリメータレンズ4からなるプロックの位置を入れ換え、半導体レーザ177を出射した波長785nmの光を、光合分波素子における誘電体多層膜にS偏光として入射させればよい。

【0192】図46は図38に示した第九の実施の形態の光へッド装置に用いる光路制御素子207の別の例の構成図を示す。この光路制御素子207は、図46

(a)、(b)に示すように、プリズム9の斜面にホログラム228が形成された構成である。図46(a)に示すように、ディスク7で反射されて光路制御素子207のプリズム9に入射した波長635nmの入射光21

7は、ホログラム228で+1次回折光として反射回折 されてプリズム9を出射する。

【0193】一方、図46(b)に示すように、モジュール100内の半導体レーザを出射して光路制御素子207のプリズム9に入射した波長785nmの入射光218は、ホログラム228ですべて反射されてプリズム9を出射する。ディスク8で反射されて光路制御素子207のプリズム9に入射した波長785nmの光は、入射光218と同じ経路を逆に通ってプリズム9を出射する。

【0194】図47は図46中のホログラム228の各例の構成図を示す。ホログラム228は、図47(a)に示すように、プリズム9の斜面に誘電体多層膜229及びホログラム層である $SiO_2$ 膜230が形成された構成である。また、図47(b)に示すホログラム228は、プリズム9の斜面に誘電体多層膜231とホログラム層である $SiO_2$ 膜232が形成された構成で、図47(a)とは $SiO_2$ 膜232の断面形状が異なる。

【0195】誘電体多層膜229及び231は、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる働きをする。ホログラム228は、+1次回折光に対して凹面ミラーとしての働きをする。

【0196】ディスク7で反射されてホログラム228に入射した波長635nmの入射光217は、誘電体多層膜229又は231をすべて透過し、 $SiO_2$ 膜230又は232で+1次回折光として反射回折され、再び誘電体多層膜229又は231をすべて透過してホログラム228を出射する。一方、モジュール100内の半導体レーザを出射してホログラム228に入射した波長785nmの入射光218は、誘電体多層膜229又は231ですべて反射されてホログラム228を出射する。ディスク8で反射されてホログラム228を出射する。ディスク8で反射されてホログラム228に入射した波長785nmの光は、入射光218と同じ経路を逆に通ってホログラム228を出射する。

【0197】図47(a)に示すように、 $SiO_2$ 膜230の断面が矩形状の場合、+1次回折光に対する回折効率は最大で40.5%である。これに対し、図47

(b) に示すように、 $SiO_2$ 膜 2 3 2 の断面を階段状にすることにより、+1 次回折光に対する回折効率が高くなる。 4 レベルの階段状の場合は最大で 8 1 %、 8 レベルの階段状の場合は最大で 9 5 % である。

【0198】図38に示した第九の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、半導体レーザ160からコリメータレンズ205までの距離はコリメータレンズ205の焦点距離と等しく、モジュール100からコリメータレンズ4までの距離はコリメータレンズ4の焦点距離よりも短い。しかし、図46に示す構成の光路制御素子を光路制御素子207として用いると、ディスク7で反射された波長635nmの光に対する集光点は、ディスク8で反射された波長785nmの光に対する集光点よりも光

路制御素子207に近付く。

【0199】従って、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、コリメータレンズ4の焦点距離と等しくすることができ、かつ、モジュール100からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、それよりも短くすることができる。

【0200】図46に示す構成の光路制御素子は、図43に示した本発明の第十一の実施の形態の光ヘッド装置に用いることも可能である。図43に示した本発明の第十一の実施の形態の光ヘッド装置の構成では、半導体レーザ177からコリメータレンズ205までの距離はコリメータレンズ205の焦点距離と等しく、モジュール99からコリメータレンズ4までの距離はコリメータレンズ4の焦点距離と等しい。

【0201】しかし、図46に示す構成の光路制御素子を光路制御素子207として用いると、ディスク7で反射された波長635nmの光に対する集光点は、ディスク8で反射された波長785nmの光に対する集光点よりも光路制御素子に近付く。従って、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長785nmの光に対する実効的な光路長を、コリメータレンズ4の焦点距離と等しくすることができ、かつ、モジュール99からコリメータレンズ4までの波長635nmの光に対する実効的な光路長を、それよりも長くすることができる。

【0202】図34に示した構成の光合分波/光路制御素子161に用いるホログラム187、図36に示した構成の光合分波/光路制御素子178に用いるホログラム196、及び図46に示した構成の光路制御素子207に用いるホログラム228の干渉縞のパターンは図11に示す通りである。

【0203】なお、図27に示した構成の光合分波/光 路制御素子161における誘電体多層膜165及び16 6、図29に示した構成の光合分波/光路制御素子17 1における誘電体多層膜175及び176、図31に示 した構成の光合分波/光路制御素子178における誘電 体多層膜179及び180、図33に示した構成の光合 分波/光路制御素子184における誘電体多層膜185 及び186、図35に示した構成のホログラム187に おける誘電体多層膜189、191、193及び19 5、図37に示した構成のホログラム196における誘 電体多層膜198、200、202及び204、図39 に示した構成の光合分波素子206における誘電体多層 膜208、図40に示した構成の光路制御素子207に おける誘電体多層膜214、図42に示した構成の光路 制御素子219における誘電体多層膜222、図44に 示した構成の光合分波素子223における誘電体多層膜 224、及び図47に示した構成のホログラム228に おける誘電体多層膜229及び231は、TiO2等の 高屈折率層とSiO<sub>2</sub>等の低屈折率層を交互に奇数層堆

積させることにより作製できる。

【0204】また、図26、図28、図30、図32、図38、図41、図43及び図45に示した本発明の各実施の形態の光ヘッド装置は、いずれも小型化のために半導体レーザと光検出器を内蔵した一個のモジュールと一個の半導体レーザを用いた構成であるが、半導体レーザと光検出器を別々に設けた一組のプロックと一個の半導体レーザを用いた構成も可能である。

【0205】図48は本発明になる光ヘッド装置の第十三の実施の形態の構成図を示す。同図中、モジュール1及びモジュール2には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール1内の半導体レーザの出射光の波長は635nm、モジュール2内の半導体レーザの出射光の波長は785nmである。また、光合分波素子3の構成は図2に示した構成と同じであり、開口制御素子5の構成は図12又は図13に示した通りである。

【0206】モジュール1内の半導体レーザからの出射 光は、コリメータレンズ205、光合分波素子3、開口 制御素子5を透過し、対物レンズ6に平行光として入射 し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mm のディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光 は、対物レンズ6、開口制御素子5、光合分波素子3、 コリメータレンズ205を逆向きに通り、モジュール1 内の光検出器で受光される。

【0207】一方、モジュール2内の半導体レーザからの出射光は、コリメータレンズ233、凹レンズ234をそれぞれ透過し、光合分波素子3で反射され、開口制御素子5を透過し、対物レンズ6に発散光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ6、開口制御素子5、光合分波素子3、凹レンズ234、コリメータレンズ233を逆向きに通り、モジュール2内の光検出器で受光される。開口制御素子5は、対物レンズ6と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0208】図48に示す第十三の実施の形態では、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜11を有する図2に示した光合分波素子3を用いている。しかし、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜を有する構成の光合分波素子を用いることも可能である。ただし、この場合は、モジュール1とモジュール2の位置を図48に示す位置と入れ換える必要がある。

【0209】また、図48に示す第十三の実施の形態では、モジュール2内の半導体レーザからの出射光を対物レンズ6に発散光として入射させるためのレンズ手段として凹レンズ234を用いている。しかし、凸レンズを用いて一旦収束させた後に発散させる構成も可能であ

る。

【0210】図49は本発明になる光ヘッド装置の第十四の実施の形態の構成図を示す。同図中、モジュール1及びモジュール2には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する光検出器が内蔵されている。モジュール1内の半導体レーザの出射光の波長は635nm、モジュール2内の半導体レーザの出射光の波長は785nmである。また、光合分波素子14の構成は図4に示した構成と同じであり、開口制御素子5の構成は図12又は図13に示した通りである。この実施の形態では、モジュール1内の半導体レーザからの出射光を対物レンズ15に収束光として入射させるためのレンズ手段として凸レンズ236を用いている点に特徴がある。

【0211】図49において、モジュール1内の半導体レーザからの出射光は、コリメータレンズ235、凸レンズ236を透過し、光合分波素子14で反射され、開口制御素子5を透過し、対物レンズ15に収束光として入射し、ディジタルビデオディスク等の基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5を透過し、光合分波素子14で反射して、凸レンズ236、コリメータレンズ235を逆向きに通り、モジュール1内の光検出器で受光される。

【0212】一方、モジュール2内の半導体レーザからの出射光は、コリメータレンズ205、光合分波素子14、開口制御素子5をそれぞれ透過し、対物レンズ15に平行光として入射し、コンパクトディスク等の基板厚さ1.2mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反射光は、対物レンズ15、開口制御素子5、光合分波素子14、コリメータレンズ205を逆向きに通り、モジュール2内の光検出器で受光される。開口制御素子5は、対物レンズ15と共にアクチュエータによりフォーカシング方向及びトラッキング方向に一体駆動される。

【0213】図49に示す第十四の実施の形態では、波長635nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて反射させ、波長785nmの光をすべて透過させる誘電体多層膜16を有する図4に示した光合分波素子14を用いている。しかし、波長635nmの光をすべて透過させ、波長785nmの光をすべて反射させる誘電体多層膜を有する構成の光合分波素子を用いることも可能である。ただし、この場合は、モジュール1とモジュール2の位置を図49に示す位置と入れ換える必要がある。

【0214】なお、図48及び図49に示す各実施の形態では、いずれも小型化のために半導体レーザと光検出器を内蔵した二個のモジュールを用いた構成であるが、半導体レーザと光検出器を別々に設けた二組のブロックを用いた構成も可能である。

[0215]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

第一の光源からの出射光を用いて第一の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行い、第二の光源からの出射光を用いて第二の基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行うことにより、従来の光へッド装置のように各々の光に対する利用効率が低下しないようにしたため、再生信号のS/Nは通常と同程度であり、光源の出力も通常と同程度で済み、再生だけでなく記録を行うことも可能である。

【0216】また、本発明によれば、第二の光源の出射 光の波長を785nmにすることにより、従来の光ヘッ ド装置では不可能であった追記型コンパクトディスクの 再生もできる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態の構成図である。

【図2】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる光合分波素子の一例の構成図である。

【図3】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態の構成図である。

【図4】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる光合分波素子の第一の例の構成図である。

【図5】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる光合分波素子の第二の例の構成図である。

【図6】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる光合分波素子の第三の例の構成図である。

【図7】本発明の光ヘッド装置の第一の実施の形態に用いる光合分波素子の別の構成を示す図である。

【図8】図7に示す構成の光合分波素子に用いるホログラムの構成を示す図である。

【図9】本発明の光ヘッド装置の第二の実施の形態に用いる光合分波素子の第四の例の構成図である。

【図10】図9に示す構成の光合分波素子に用いるホログラムの構成を示す図である。

【図11】図7及び図9に示す構成の光合分波素子に用いるホログラムの干渉縞のパターンを示す図である。

【図12】本発明の光ヘッド装置の第一及び第二の実施の形態に用いる開口制御素子の一例の構成図である。

【図13】本発明の光ヘッド装置の第一及び第二の実施の形態に用いる開口制御素子の別の構成図である。

【図14】本発明の光ヘッド装置の第一及び第二の実施 の形態に用いるモジュールの一例の構成図である。

【図15】図14に示す構成のモジュールに用いる回折 光学素子及びホログラム光学素子の干渉縞のパターンを 示す図である。

【図16】図15 (a) に示す構成の回折光学素子及び図15 (b) に示す構成のホログラム光学素子を用いた場合の、図14に示す構成のモジュールに用いる光検出器の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図17】図14に示す構成のモジュールに用いるホロ

グラム光学素子の別の干渉縞のパターンを示す図であ る。

【図18】図15 (a) に示す構成の回折光学素子及び図17に示す構成のホログラム光学素子を用いた場合の、図14に示す構成のモジュールに用いる光検出器の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図19】本発明の光ヘッド装置の第三の実施の形態の 構成図である。

【図20】本発明の光ヘッド装置の第四の実施の形態の 構成図である。

【図21】本発明の光ヘッド装置の第三及び第四の実施の形態に用いるモジュールの一例の構成図である。

【図22】本発明の光ヘッド装置の第三及び第四の実施 の形態に用いる偏光性ホログラム光学素子の断面形状及 び干渉縞のパターンを示す図である。

【図23】図22に示す構成の偏光性ホログラム光学素子を用いた場合の、図21に示す構成のモジュールに用いる光検出器の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図24】本発明の光ヘッド装置の第三及び第四の実施 の形態に用いる偏光性ホログラム光学素子の別の干渉縞 のパターンを示す図である。

【図25】図24に示す構成の偏光性ホログラム光学素子を用いた場合の、図21に示す構成のモジュールに用いる光検出器の受光部のパターンと、受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図26】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態の構成図である。

【図27】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態に 用いる光合分波/光路制御素子の一例の構成図である。

【図28】本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態の構成図である。

【図29】本発明の光ヘッド装置の第六の実施の形態に 用いる光合分波/光路制御素子の一例の構成図である。

【図30】本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態の構成図である。

【図31】本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態に 用いる光合分波/光路制御素子の一例の構成図である。

【図32】本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態の 構成図である。

【図33】本発明の光ヘッド装置の第八の実施の形態に用いる光合分波/光路制御素子の一例の構成図である。

【図34】本発明の光ヘッド装置の第五の実施の形態に 用いる光合分波/光路制御素子の別の構成を示す図であ る

【図35】図34に示す構成の光合分波/光路制御素子 に用いるホログラムの構成を示す図である。

【図36】本発明の光ヘッド装置の第七の実施の形態に 用いる光合分波/光路制御素子の別の構成を示す図であ る。

【図37】図36に示す構成の光合分波/光路制御素子 に用いるホログラムの構成を示す図である。

【図38】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態の構成図である。

【図39】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態に 用いる光合分波素子の一例の構成図である。

【図40】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態に 用いる光路制御素子の一例の構成図である。

【図41】本発明の光ヘッド装置の第十の実施の形態の 構成図である。

【図42】本発明の光ヘッド装置の第十の実施の形態に 用いる光路制御素子の一例の構成図である。

【図43】本発明の光ヘッド装置の第十一の実施の形態の構成図である。

【図44】本発明の光ヘッド装置の第十一の実施の形態 に用いる光合分波素子の一例の構成図である。

【図45】本発明の光ヘッド装置の第十二の実施の形態の構成図である。

【図46】本発明の光ヘッド装置の第九の実施の形態に 用いる光路制御素子の別の構成を示す図である。

【図47】図46に示す構成の光路制御素子に用いるホログラムの構成を示す図である。

【図48】本発明の光ヘッド装置の第十三の実施の形態 の構成図である。

【図49】本発明の光ヘッド装置の第十四の実施の形態の構成図である。

【図50】従来の光ヘッド装置の一例の構成図である。

【図51】従来の光ヘッド装置の構成に用いる光路制御素子の一例の構成図である。

【図52】従来の光ヘッド装置の構成に用いる光路制御素子の別の例の構成図である。

【図53】図52に示す構成の光路制御素子に用いるホログラムの構成を示す図である。

## 【符号の説明】

1、2、99、100 モジュール

3、14、206、223 光合分波素子

4、205、233、235 コリメータレンズ

5 開口制御素子

6、15 対物レンズ

7 第一の基板厚さのディスク (光記録媒体)

8 第二の基板厚さのディスク (光記録媒体)

 $9, 10, 19, 20, 23, 24, 162 \sim 164,$ 

172~174, 212, 213, 220, 221, 2

43、244 プリズム

11, 16, 21, 25, 28, 31, 35, 38, 4

1, 44, 165, 166, 189, 191, 193,

195, 198, 200, 202, 204, 208, 2

14、222、224、229、231 誘電体多層膜 12、19、17、18、168~170、181~1

83, 209~211, 217, 218, 225~22

7、248、249 入射光

26、33、187、196、228、250 ホログ ラム

27, 30, 34, 37, 42, 43, 47, 188,

192、197、201、230、232 SiO<sub>9</sub>膜

29, 32, 36, 39, 45, 190, 194, 19

9、203 接着剤40、46 ガラス基板

48、107、160、177、237 半導体レーザ

49、108、242 光検出器

50 パッケージ

51 回折光学素子

52 ホログラム光学素子

53 スペーサ

54、73、74、112~115、136~139 領域

55 ヒートシンク

56 ミラー

 $57 \sim 66$ ,  $75 \sim 86$ ,  $116 \sim 127$ ,  $140 \sim 1$ 

51 受光部

67~72 、87~98、128~135、152~ 159光スポット

101、104 1/2波長板

102、105 偏光性ホログラム光学素子

103、106 1/4波長板

109 ニオブ酸リチウム基板

110 プロトン交換領域

 $111 \text{ Nb}_2\text{O}_5$ 

161、171、178、184 光合分波/光路制御 素子

207、219、240 光路制御素子

234、241 凹レンズ

236 凸レンズ

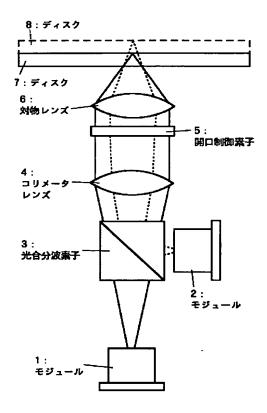
238 ハーフミラー

239 開口

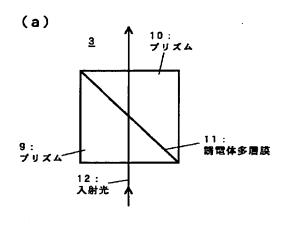
245、251 偏光分離膜

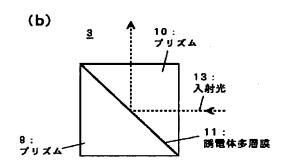
252 ホログラム層

【図1】

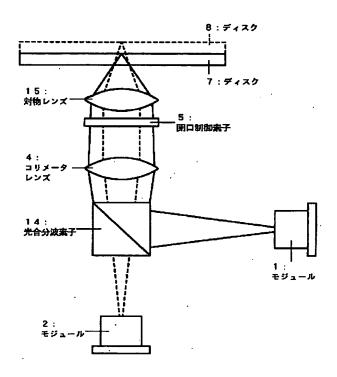


【図2】

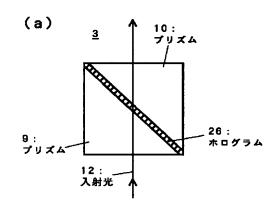


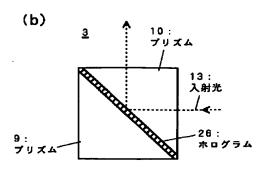


[図3]

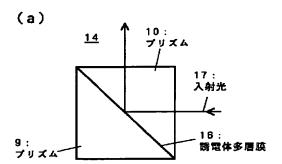


【図7】

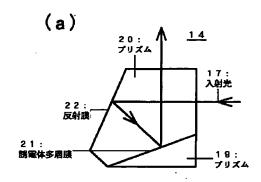


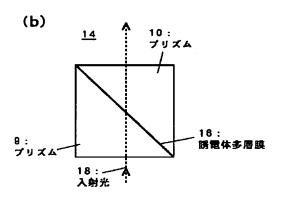


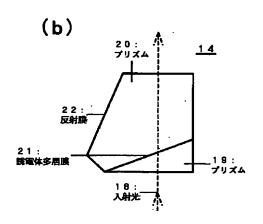
【図4】



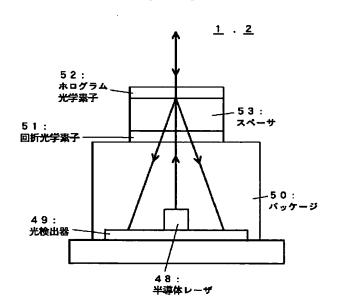
[図5]



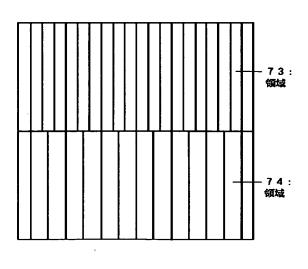


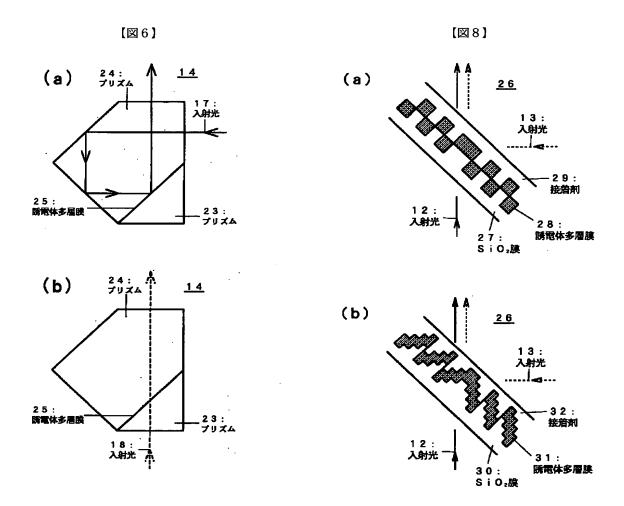


【図14】



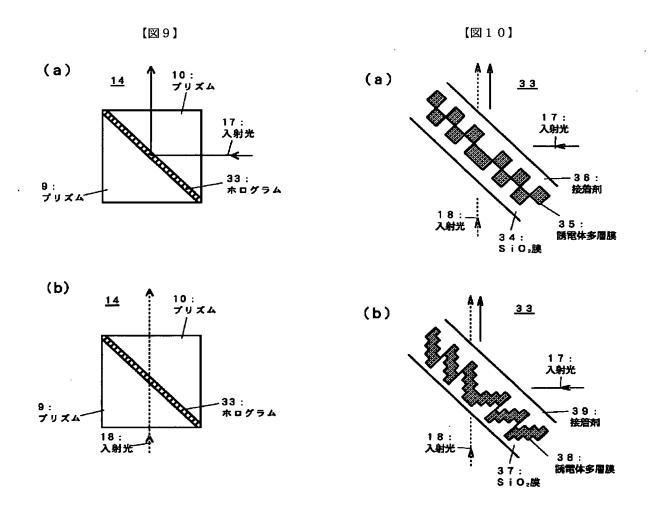
【図17】



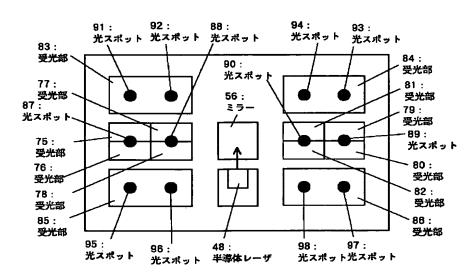


(a) (b) 70: 光スポット 69: 光スポット 67: 光スポット 63: 受光部 受光部 57: 受光部 受光部 58: 受光部 59: 62: 受光部 受光部 48: 85:1 受光部 半導体レ 8 8 : 受光部 72: 48: 半導体レーザ 71: 光スポット 55: ヒートシンク 光スポット

【図16】

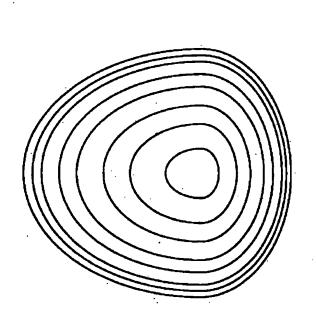


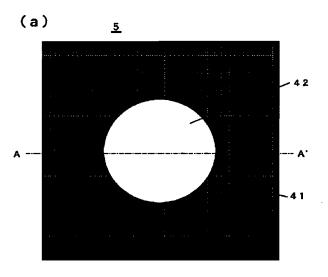
【図18】

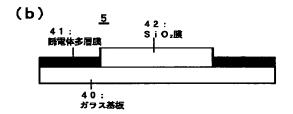


【図11】

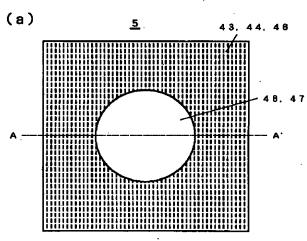


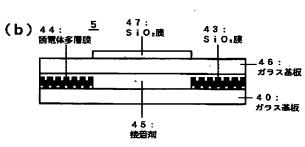


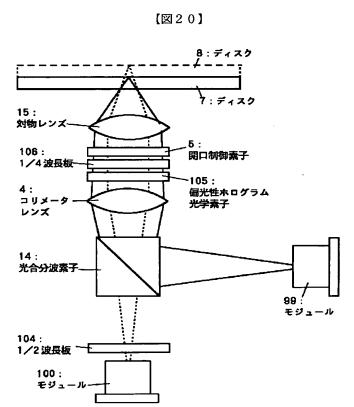


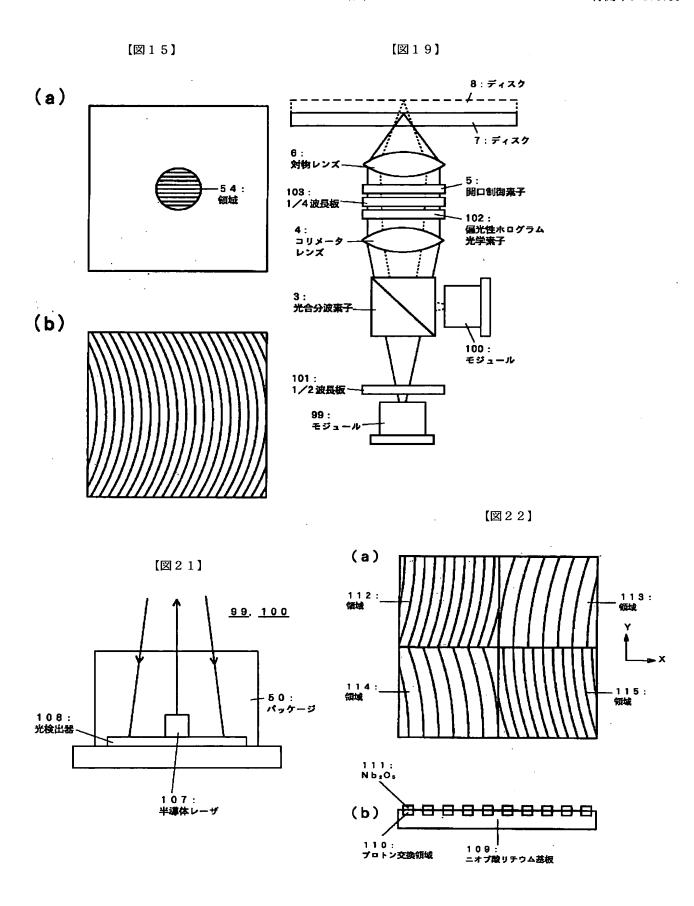


【図13】

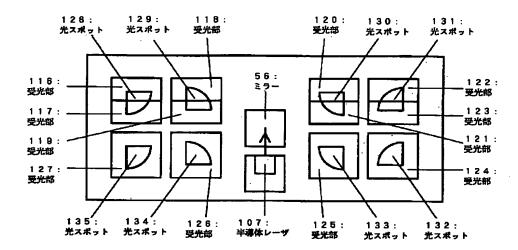




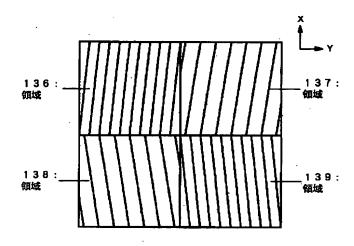




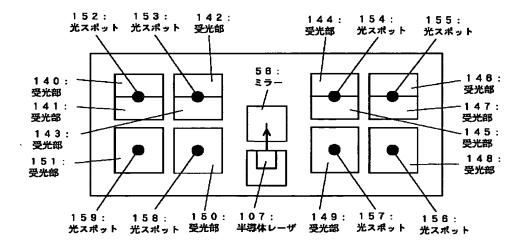
【図23】



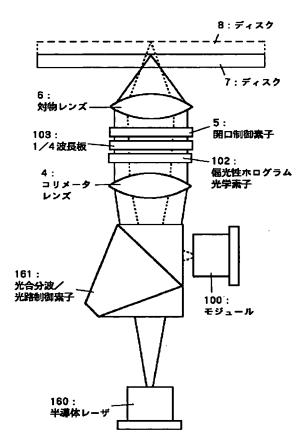
【図24】



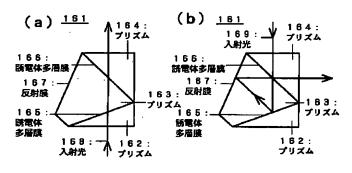
【図25】

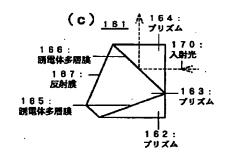


[図26]

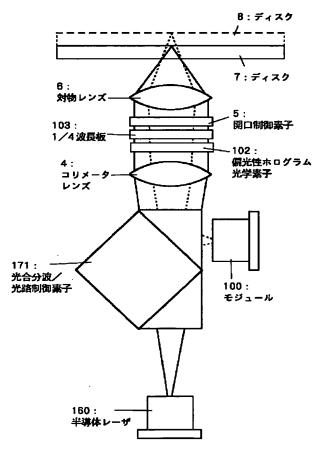


【図27】



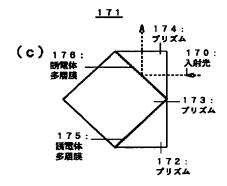


【図28】

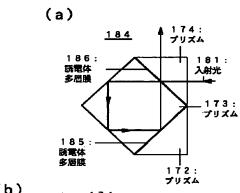


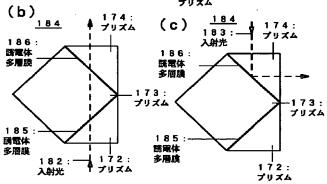
【図29】

(a)  $_{171}$ (b)<sub>171</sub> 174: プリズム 169:<u></u> 入射光 174: プリズム 178: 176: 師電体 多層膜 誘電体 多層膜 -173: プリズム プリズム 175 175: 誘電体 多層膜 時電体 多層膜 172: プリズム 168: 入射光 プリズム

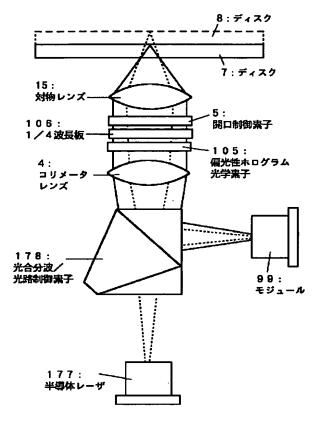


【図33】

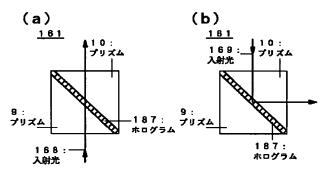


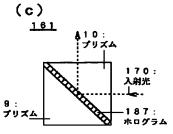


【図30】

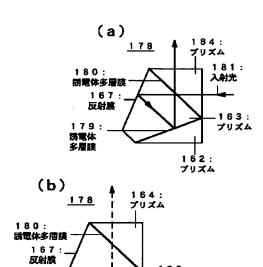


【図34】



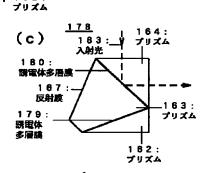


【図31】



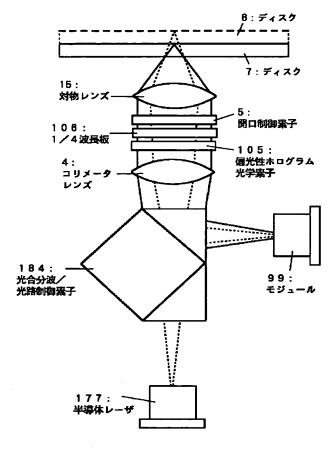
179: 誘電体 多層膜

182 入射光

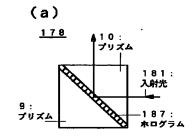


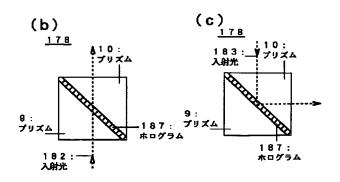
\_168: プリズム

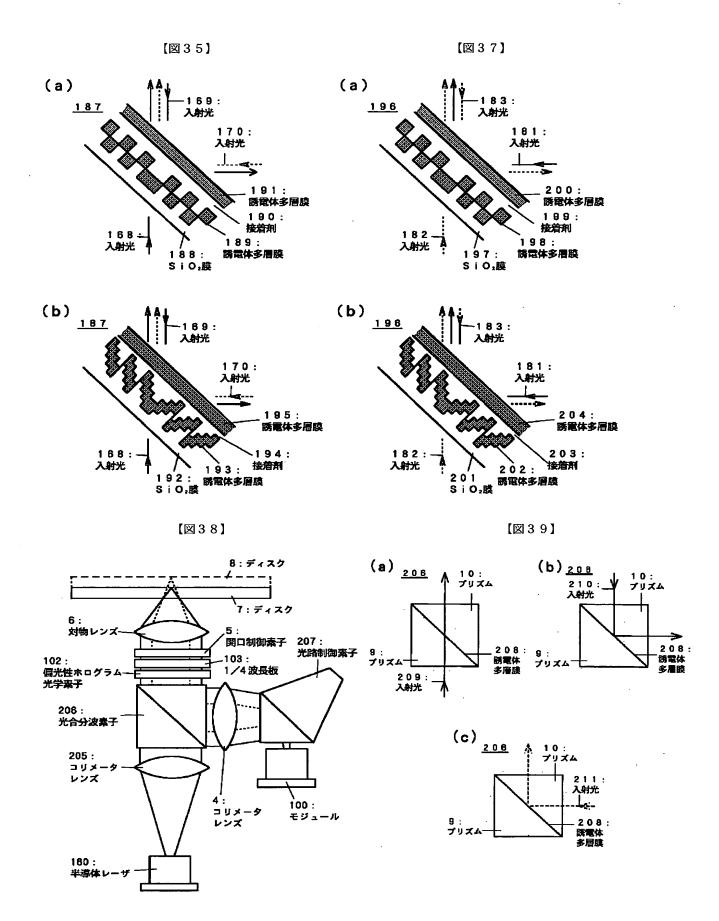
## [図32]



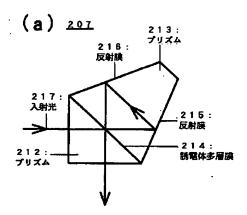
【図36】

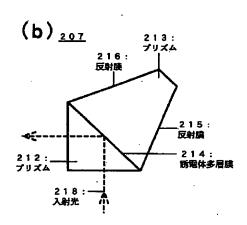




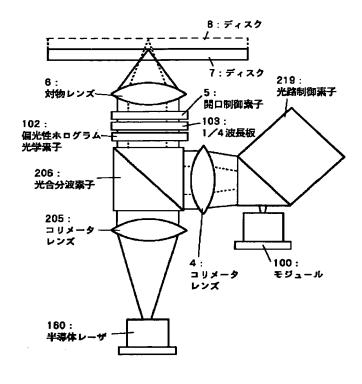


【図40】

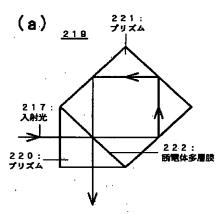


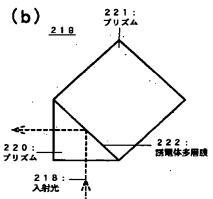


【図41】

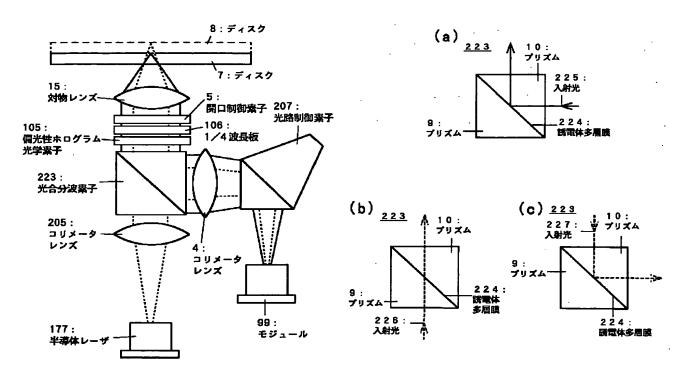


[図42]

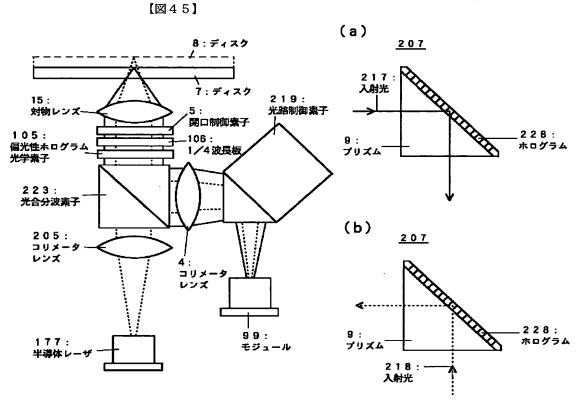




[図43] (図44)

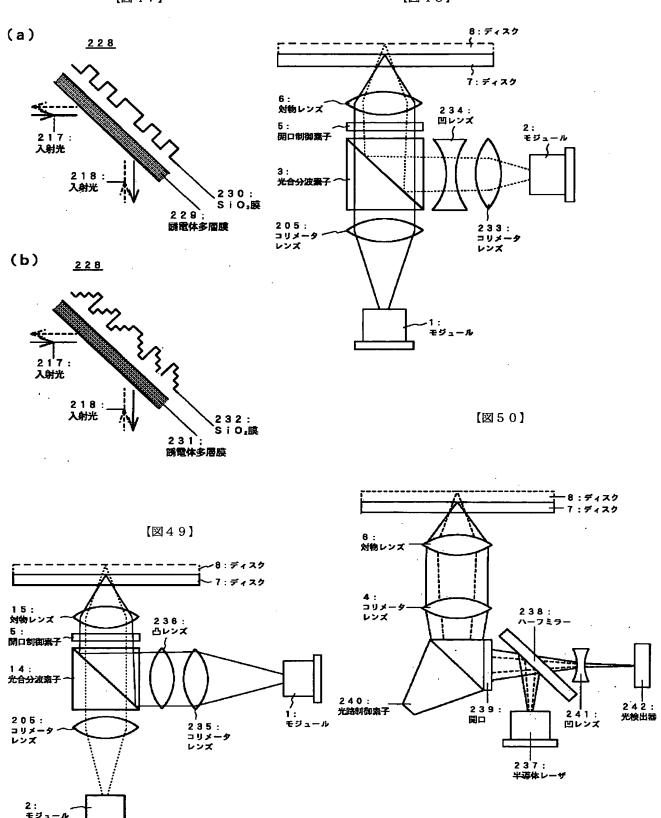


【図46】

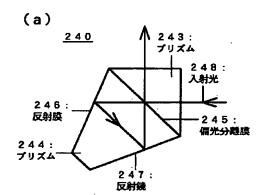


【図47】

【図48】



【図51】



【図52】

